

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-166104

(P2001-166104A)

(43)公開日 平成13年6月22日 (2001.6.22)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード*(参考)
G 0 2 B 1/11		B 3 2 B 7/02	1 0 3
B 3 2 B 7/02	1 0 3	23/08	
23/08		27/20	Z
27/20		27/30	D
27/30		G 0 2 B 5/30	

審査請求 未請求 請求項の数20 O L (全 23 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-297468(P2000-297468)

(71)出願人 000005201

富士写真フィルム株式会社
神奈川県南足柄市中沼210番地

(22)出願日 平成12年9月28日 (2000.9.28)

(72)発明者 中村 謙一

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真
フィルム株式会社内

(31)優先権主張番号 特願平11-275337

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

(32)優先日 平成11年9月28日 (1999.9.28)

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(54)【発明の名称】 反射防止膜、偏光板、及びそれを用いた画像表示装置

(57)【要約】

【課題】屈折率が非常に高く透明で、物理的強度（耐磨耗性など）と耐候性（耐光性、耐湿熱性）に優れた高屈折率層を有する、大量生産に適した反射防止膜、偏光板およびこれを用いた適切な手段により反射が防止されている画像表示装置を提供する。

【解決手段】平均粒径1～200nmのコア／シェル構造を有する無機微粒子を5～65体積%、有機化合物から成るポリマーを35～95体積%含有し、屈折率が1.65～2.40である高屈折率層と屈折率が1.30～1.55である低屈折率層を積層してなる反射防止膜、偏向板およびこれを用いた画像表示装置。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平均粒径1～200nmのコア／シェル構造を有する無機微粒子を5～65体積%、有機化合物から成るポリマーを35～95体積%含有し、屈折率が1.65～2.40である高屈折率層と屈折率が1.30～1.55である低屈折率層とが積層してなることを特徴とする反射防止膜。

【請求項2】 コア／シェル構造を有する無機微粒子が、該コアの主成分が二酸化チタン、該シェルの主成分が二酸化チタン以外の無機化合物であり、シェルがコアに対し2～50重量%であることを特徴とする請求項1に記載の反射防止膜。

【請求項3】 シェルを構成する該無機化合物が、アルミナ、シリカ、ジルコニアから選ばれる少なくとも1種を主成分とすることを特徴とする請求項1または2に記載の反射防止膜。

【請求項4】 シェルを構成する該無機化合物が、アルミナを主成分とすることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の反射防止膜。

【請求項5】 該高屈折率層の有機化合物から成るポリマーが、架橋しているアニオン性基を有するポリマーであることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の反射防止膜。

【請求項6】 該高屈折率層のアニオン性基を有するポリマーが、リン酸基またはスルホン酸基をアニオン性基として有することを特徴とする請求項5に記載の反射防止膜。

【請求項7】 該高屈折率層のアニオン性基を有するポリマーが、さらにアミノ基またはアンモニウム基を有することを特徴とする請求項5または6に記載の反射防止膜。

【請求項8】 該高屈折率層が塗布により形成された層であり、アニオン性基を有するポリマーが層の塗布と同時に塗布後に、重合反応により形成されたポリマーであることを特徴とする請求項1～7のいずれかに記載の反射防止膜。

【請求項9】 該低屈折率層が、0.5～200nmの平均粒径を有する無機微粒子を50～95重量%およびポリマーを5～50重量%含み、該無機微粒子間に空隙が形成されている層であることを特徴とする請求項1～8のいずれかに記載の反射防止膜。

【請求項10】 該高屈折率層、又は、該低屈折率層の少なくとも一方が、酸素濃度が15体積%以下の雰囲気で電離放射線硬化性樹脂組成物の架橋反応、又は重合反応により形成された層であることを特徴とする請求項1～9のいずれかに記載の反射防止膜。

【請求項11】 該酸素濃度が15体積%以下の雰囲気が、窒素ページにより実現されていることを特徴とする請求項10に記載の反射防止膜。

【請求項12】 該酸素濃度が6体積%以下の雰囲気で

あることを特徴とする請求項10または11に記載の反射防止膜。

【請求項13】 該低屈折率層の上に含フッ素化合物を含むオーバーコート層が積層されていることを特徴とする請求項1～12のいずれかに記載の反射防止膜。

【請求項14】 該オーバーコート層の材料が低屈折率層の空隙を占有している割合が70体積%未満であることを特徴とする請求項13に記載の反射防止膜。

【請求項15】 該含フッ素化合物がフッ素ポリマーであり、該含フッ素ポリマーがオーバーコート層の塗布と同時に塗布後に、架橋反応、又は、重合反応により形成された含フッ素ポリマーであることを特徴とする請求項13または14に記載の反射防止膜。

【請求項16】 該請求項1～15に記載の反射防止膜が、トリアセチルセルロースから形成される透明支持体上に形成されていることを特徴とする反射防止膜。

【請求項17】 該低屈折率層を有する側の表面の動摩擦計数が0.25以下であることを特徴とする請求項1～16のいずれかに記載の反射防止膜。

【請求項18】 該低屈折率層を有する側の表面の、水に対する接触角が90°以上であることを特徴とする請求項1～17のいずれかに記載の反射防止膜。

【請求項19】 請求項1～18のいずれかに記載の反射防止膜を偏光膜の保護膜の少なくとも一方に有することを特徴とする偏光板。

【請求項20】 画像表示面上に請求項1～18のいずれかに記載の反射防止膜、又は、請求項19に記載の偏光板を配置していることを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、コア／シェル構造を有する無機微粒子を含有する高屈折率層と、低屈折率層を有する反射防止膜、偏光板、およびそれを用いた画像表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 反射防止膜は、液晶表示装置(LCD)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、エレクトロルミネッセンスディスプレイ(ELD)や陰極管表示装置(CRT)のような様々な画像表示装置に設けられている。眼鏡やカメラのレンズにも反射防止膜が設けられている。反射防止膜としては、金属酸化物の透明薄膜を積層させた多層膜が従来から普通に用いられている。複数の透明薄膜を用いるのは、様々な波長の光の反射を防止するためである。金属酸化物の透明薄膜は、化学蒸着(CVD)法や物理蒸着(PVD)法、特に物理蒸着法の一種である真空蒸着法により形成されている。金属酸化物の透明薄膜は、反射防止膜として優れた光学的性質を有しているが、蒸着による形成方法は、生産性が低く大量生産に適していない。蒸着法に代えて、無機微粒子の塗布により反射防止膜を形成する方法が提案さ

れている。

【0003】特公昭60-59250号公報は、微細な空隙と微粒子状無機物とを有する反射防止層を開示している。反射防止層は、塗布により形成される。微細な空隙は、層の塗布後に活性化ガス処理を行ない、ガスが層から離脱することによって形成される。特開昭59-50401号公報は、支持体、高屈折率層および低屈折率層の順に積層した反射防止膜を開示している。同公報は、支持体と高屈折率層の間に中屈折率層を設けた反射防止膜も開示している。低屈折率層は、ポリマーまたは無機微粒子の塗布により形成されている。特開平2-245702号公報は、二種類以上の超微粒子（例えば、Mg F₂とSiO₂）を混在させて、膜厚方向にその混合比を変化させた反射防止膜を開示している。混合比を変化させることにより屈折率を変化させ、上記特開昭59-50401号公報に記載されている高屈折率層と低屈折率層を設けた反射防止膜と同様の光学的性質を得ている。超微粒子は、エチルシリケートの熱分解で生じたSiO₂により接着している。エチルシリケートの熱分解では、エチル部分の燃焼によって、二酸化炭素と水蒸気も発生する。同公報の第1図に示されているように、二酸化炭素と水蒸気が層から離脱することにより、超微粒子の間に空隙が生じている。特開平5-13021号公報は、上記特開平2-245702号公報記載の反射防止膜に存在する超微粒子間の空隙をバインダーで充填することを開示している。特開平7-48527号公報は、多孔質シリカよりなる無機微粉末とバインダーとを含有する反射防止膜を開示している。特開平8-110401号、同8-179123号の各公報には、プラスチック中に高屈折率の無機微粒子を導入することで、屈折率1.80以上の高屈折率皮膜を形成し、反射防止膜に適用することが開示されている。

【0004】無機微粒子の塗布により高屈折率層を形成する方法は、生産性が高く大量生産に適している。無機微粒子を微細に分散し、その微細な分散状態を保ったまま高屈折率層を形成することで透明な高屈折率層が形成される。また、高い屈折率を有する無機微粒子をより多く高屈折率層に導入することで、より高い屈折率を有する高屈折率層が形成される。高屈折率層に、着色がなく特に高い屈折率を有する二酸化チタン微粒子を導入することは非常に有効である。一方、高屈折率層は画像表示装置の表示面やレンズの外側表面に配置される。そのため、高屈折率層には高い物理的強度（耐摩耗性など）と耐候性（耐光性、耐湿熱性など）が要求される。二酸化チタン微粒子は、光触媒機能を有しているため粒子に接する有機化合物を分解し、物理的強度、透明性などを著しく悪化させる。更に、高屈折率層の屈折率の低下を起こす。このような現象は二酸化チタン微粒子が微細な分散状態を保っている高屈折率層において特に顕著に発生する。また、偏光板は液晶表示装置（LCD）において

不可欠な光学材料である。偏光板は、一般に、偏光膜が二枚の保護膜によって保護されている構造をしている。これらの保護膜に反射防止機能を付与することで大幅なコスト削減、表示装置の薄手化が可能となる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、大量生産に適した反射防止膜を提供することである。また、本発明の目的は、屈折率が非常に高く透明な高屈折率層を有する反射防止膜を提供することである。さらに、本発明の目的は、物理的強度（耐摩耗性など）と耐候性（耐光性、耐湿熱性）に優れた高屈折率層を有する反射防止膜を提供することである。さらにまた、本発明の目的は、適切な手段により反射防止処理されている偏光板、画像表示装置を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記

（1）から（18）の反射防止膜、下記（19）の偏光板、および下記（20）の画像表示装置において達成された。

（1）平均粒径1～200nmのコア／シェル構造を有する無機微粒子を5～65体積%、有機化合物から成るポリマーを35～95体積%含有し、屈折率が1.65～2.40である高屈折率層と屈折率が1.30～1.55である低屈折率層とが積層してなることを特徴とする反射防止膜。

（2）コア／シェル構造を有する無機微粒子が、該コアの主成分が二酸化チタン、該シェルの主成分が二酸化チタン以外の無機化合物であり、シェルがコアに対し2～50重量%であることを特徴とする（1）に記載の反射防止膜。

（3）シェルを構成する該無機化合物が、アルミナ、シリカ、ジルコニアから選ばれる少なくとも1種を主成分とすることを特徴とする（1）または（2）に記載の反射防止膜。

（4）シェルを構成する該無機化合物が、アルミナを主成分とすることを特徴とする（1）～（3）のいずれかに記載の反射防止膜。

（5）該高屈折率層の有機化合物から成るポリマーが、架橋しているアニオン性基を有するポリマーであることを特徴とする（1）～（4）のいずれかに記載の反射防止膜。

（6）該高屈折率層のアニオン性基を有するポリマーが、リン酸基またはスルホン酸基をアニオン性基として有することを特徴とする（5）に記載の反射防止膜。

（7）該高屈折率層のアニオン性基を有するポリマーが、さらにアミノ基またはアンモニウム基を有することを特徴とする（5）または（6）に記載の反射防止膜。

（8）該高屈折率層が塗布により形成された層であり、アニオン性基を有するポリマーが層の塗布と同時または塗布後に、重合反応により形成されたポリマーであるこ

とを特徴とする(1)～(7)のいずれかに記載の反射防止膜。

(9) 該低屈折率層が、0.5～200nmの平均粒径を有する無機微粒子を50～95重量%およびポリマーを5～50重量%含み、該無機微粒子間に空隙が形成されている層であることを特徴とする(1)～(8)のいずれかに記載の反射防止膜。

【0007】(10) 該高屈折率層、又は、該低屈折率層のどちらか一方が、酸素濃度が15体積%以下の雰囲気で電離放射線硬化性樹脂組成物の架橋反応、又は、重合反応により形成された層であることを特徴とする(1)～(9)のいずれかに記載の反射防止膜。

(11) 該酸素濃度が15体積%以下の雰囲気が、窒素ページにより実現されていることを特徴とする(10)に記載の反射防止膜。

(12) 該酸素濃度が6体積%以下の雰囲気であることを特徴とする(10)または(11)に記載の反射防止膜。

(13) 該低屈折率層の上に含フッ素化合物を含むオーバーコート層が積層されていることを特徴とする(1)～(12)のいずれかに記載の反射防止膜。

(14) 該オーバーコート層の材料が低屈折率層の空隙を占有している割合が70体積%未満であることを特徴とする(13)に記載の反射防止膜。

(15) 該含フッ素化合物がフッ素ポリマーであり、該含フッ素ポリマーがオーバーコート層の塗布と同時に塗布後に、架橋反応、又は、重合反応により形成された含フッ素ポリマーであることを特徴とする(13)または(14)に記載の反射防止膜。

(16) (1)～(15)に記載の反射防止膜が、トリアセチルセルロースから形成される透明支持体上に形成されていることを特徴とする反射防止膜。

(17) 該低屈折率層を有する側の表面の動摩擦係数が0.25以下であることを特徴とする(1)～(16)のいずれかに記載の反射防止膜。

(18) 該低屈折率層を有する側の表面の、水に対する接触角が90°以上であることを特徴とする(1)～(17)のいずれかに記載の反射防止膜。

(19) (1)～(18)のいずれかに記載の反射防止膜を偏光膜の保護膜の少なくとも一方に有することを特*40

$$(II) \quad \frac{n}{4} \lambda \times 0.7 < n_1 d_1 < \frac{m}{4} \lambda \times 1.3$$

【0012】式中、nは正の奇数(一般に1)であり、n₁は低屈折率層の屈折率であり、そして、d₁は低屈折率層の層厚(nm)である。図1の(c)に示す態様は、透明支持体(3)、ハードコート層(4)、中屈折率層(5)、高屈折率層(1)、低屈折率層(2)、そしてオーバーコート層(6)の順序の層構成を有する。透明支持体(3)と中屈折率層(5)と高屈折率層

* 像とする偏光板。

(20) 画像表示面上に(1)～(18)のいずれかに記載の反射防止膜、又は、(19)に記載の偏光板を配置していることを特徴とする画像表示装置。

【0008】

【発明の実施の形態】本発明の反射防止膜の基本的な構成を図面を引用しながら説明する。図1は、反射防止膜の主な層構成を示す断面模式図である。図1の(a)に示す態様は、透明支持体(3)、ハードコート層

10 (4)、高屈折率層(1)、そして低屈折率層(2)の順序の層構成を有する。透明支持体(3)と高屈折率層(1)と低屈折率層(2)は以下の関係を満足する屈折率を有する。高屈折率層の屈折率>透明支持体の屈折率>低屈折率層の屈折率なお、ガラスのような堅い物質の表面(CRTの画像表面や眼鏡やカメラのレンズ表面)に、反射防止膜を設ける場合は、透明支持体(3)、ハードコート層(4)なしで、高屈折率層(1)や低屈折率層(2)を直接、画像表示面あるいはレンズ表面に形成してもよい。図1の(b)に示す態様は、透明支持体(3)、ハードコート層(4)、高屈折率層(1)、低屈折率層(2)、そしてオーバーコート層(6)の順序の層構成を有する。透明支持体(3)と高屈折率層(1)と低屈折率層(2)は以下の関係を満足する屈折率を有する。

高屈折率層の屈折率>透明支持体の屈折率>低屈折率層の屈折率

(a)、又は、(b)のような層構成の反射防止膜は、特開昭59-50401号公報に記載されているように、高屈折率層が下記式(I)、低屈折率層が下記式(II)をそれぞれ満足することが好ましい。

【0009】

【数1】

$$(I) \quad \frac{m}{4} \lambda \times 0.7 < n_1 d_1 < \frac{m}{4} \lambda \times 1.3$$

【0010】式中、mは正の整数(一般に1、2または3)であり、n₁は高屈折率層の屈折率であり、そして、d₁は高屈折率層の層厚(nm)である。

【0011】

【数2】

$$(II) \quad \frac{n}{4} \lambda \times 0.7 < n_2 d_2 < \frac{n}{4} \lambda \times 1.3$$

(1)と低屈折率層(2)は以下の関係を満足する屈折率を有する。

高屈折率層の屈折率>中屈折率層の屈折率>透明支持体の屈折率>

低屈折率層の屈折率

(c)のような層構成の反射防止膜は、特開昭59-50401号公報に記載されているように、中屈折率層が

下記式 (III)、高屈折率層が下記式 (IV)、低屈折率層
が下記式 (V) をそれぞれ満足することが好ましい。 * 【0013】
* 【数3】

$$(III) \quad \frac{h}{4} \lambda \times 0.7 < n_s d_s < \frac{h}{4} \lambda \times 1.3$$

【0014】式中、hは正の整数（一般に1、2または3）であり、n_sは中屈折率層の屈折率であり、そして、d_sは中屈折率層の層厚（nm）である。 * 【数4】

$$(IV) \quad \frac{j}{4} \lambda \times 0.7 < n_s d_s < \frac{j}{4} \lambda \times 1.3$$

【0016】式中、jは正の整数（一般に1、2または3）であり、n_sは高屈折率層の屈折率であり、そして、d_sは高屈折率層の層厚（nm）である。 ★ 【数5】

$$(V) \quad \frac{k}{4} \lambda \times 0.7 < n_s d_s < \frac{k}{4} \lambda \times 1.3$$

【0018】式中、kは正の奇数（一般に1）であり、n_sは低屈折率層の屈折率であり、そして、d_sは低屈折率層の層厚（nm）である。また、式 (I) ~ (V) 中のλは可視光線の波長であり、380~680nmの範囲の値である。ここで記載した高屈折率、中屈折率、低屈折率とは層相互の相対的な屈折率の高低をいう。

【0019】【高屈折率層および中屈折率層の無機微粒子】高屈折率層、及び中屈折率層は本発明のコア／シェル構造を有する無機微粒子を含有させて作製することが好ましい。図2 (a)、(b) は、高屈折率層、及び中屈折率層に用いる無機微粒子の好ましい形態の断面図である。図2 (a) はコア (7) の周りにシェル (8) が形成されている。図2 (b) はコア (7) の周りにシェル (8) が形成され、シェル (8) の周りにさらにシェル (9) が形成されている。シェルは、図2 (a) に示すようにコア (7) の周りに1層形成させてもよいが、耐候性（耐光性、耐湿熱性）をさらに向上させるために複数層（図2 (b) では2層）形成させてもよい。コア (7) は、シェルにより完全に被覆されていることが好ましい。

【0020】コア (7) は二酸化チタン（例、ルチル、ルチル／アナターゼの混晶、アナターゼ、アモルファス構造）を主成分とする。ルチル構造が好ましい。シェル (8)、およびシェル (9) は二酸化チタン以外の無機化合物を主成分とする。主成分とは構成する成分の中で最も含有量（重量%）が多い成分を意味する。シェル (8)、およびシェル (9) は、二酸化チタン以外の無機化合物から形成される。金属の酸化物または硫化物から形成することが好ましい。例えば、二酸化珪素（シリカ）、酸化アルミニウム（アルミナ）、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、酸化錫、酸化アンチモン、酸化インジウム、酸化鉄、硫化亜鉛などを主成分とした無機化合物が用いられる。二酸化珪素（シリカ）、酸化アルミニウム

（アルミナ）、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛が好ましく、特に酸化アルミニウム（アルミナ）、二酸化ケイ素（シリカ）が好ましい。また、これらの混合物でもよい。他の元素の例には、Ti、Zr、Sn、Sb、Cu、Fe、Mn、Pb、Cd、As、Cr、Hg、Zn、Al、Mg、Si、P およびSが含まれる。コア (7) に対するシェル (8)、およびシェル (9) の被覆量は、平均の被覆量で2乃至50重量%である。好ましくは3乃至40重量%、特に好ましくは4乃至25重量%である。

【0021】コア (7) の周りにシェル (8) を形成させる手法としては、まずコア (7) となる二酸化チタン微粒子を形成させ、その後シェル (8) をコア (7) の周りに形成させる手法が最も好ましい。コア (7) となる二酸化チタンは一般に塩素法、または硫酸法で作製される。例えば、酸化チタン－物性と応用（清野学著、第2章）に記載されている。また、シェル (8) をコア (7) の周りに形成させる手法が特許、文献に例示されている。例えば、シェルとして酸化アルミニウム（アルミナ）を形成させる手法が英国特許1,134,249号に記載されている。シェルとして低密度で多孔質な二酸化珪素（シリカ）を形成させる手法が米国特許3,410,708号、F

40 ATIPEC Congr. X I V (p. 697 (1978); H. Weber)、高密度で緻密な二酸化珪素（シリカ）を形成させる手法が特公昭58-47061号公報、米国特許2,885,366号、同3,437,502号に記載されている。このほか、シェルとして酸化ジルコニウムを形成させる手法が米国特許3,383,231号、英国特許2,629,953号に、酸化錫を形成させる手法が英国特許1,365,999号、酸化アンチモンを形成させる手法がオランダ148,354号に記載されている。

【0022】高屈折率層、及び中屈折率層に用いる無機微粒子として市販されているものも好ましく用いることができる。無機微粒子の屈折率は1.80乃至2.60

であることが好ましく、1.90乃至2.50であることがさらに好ましい。無機微粒子の一次粒子の重量平均径は、1乃至150nmであることが好ましく、1乃至100nmであることがさらに好ましく、1乃至80nmであることが最も好ましい。

【0023】高屈折率層、及び中屈折率層に含まれる場合、分散した無機微粒子の重量平均径は、1乃至200nmである。好ましくは5乃至150nm、更に好ましくは10乃至100nm、特に好ましくは10乃至80nmである。無機微粒子の平均粒径は、光散乱法や電子顕微鏡写真により測定できる。無機微粒子の比表面積は、10乃至400m²/gであることが好ましく、20乃至200m²/gであることがさらに好ましく、30乃至150m²/gであることが最も好ましい。

【0024】無機微粒子の形状は、米粒状、球形状、立方体状、紡錘形状あるいは不定形状であることが好ましい。無機微粒子は、有機化合物により表面処理してもよい。表面処理に用いる有機化合物の例には、ポリオール、アルカノールアミン、ステアリン酸、シランカップリング剤およびチタネートカップリング剤が含まれる。シランカップリング剤が最も好ましい。二種類以上の表面処理を組み合わせて実施してもよい。二種類以上の無機微粒子を高屈折率層、及び中屈折率層で併用してもよい。高屈折率層、及び中屈折率層の無機微粒子の割合は、5乃至65体積%である。10乃至60体積%であることが好ましく、20乃至55体積%であることがさらに好ましい。

【0025】無機微粒子は、分散物の状態で高屈折率層、及び中屈折率層の形成に使用する。高屈折率層の無機微粒子の分散媒体は、沸点が60乃至170℃の液体を用いることが好ましい。分散媒体の例には、水、アルコール（例、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、ベンジルアルコール）、ケトン（例、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサン）、エステル（例、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロピル、蟻酸ブチル）、脂肪族炭化水素（例、ヘキサン、シクロヘキサン）、ハロゲン化炭化水素（例、メチレンクロライド、クロロホルム、四塩化炭素）、芳香族炭化水素（例、ベンゼン、トルエン、キシレン）、アミド（例、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、n-メチルピロリドン）、エーテル（例、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラハイドロフラン）、エーテルアルコール（例、1-メトキシ-2-ブロノール）が含まれる。トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサンおよびブタノールが特に好ましい。

【0026】無機微粒子は、分散機を用いて媒体中に分散できる。分散機の例には、サンドグラインダーミル（例、ピン付きビーズミル）、高速インペラーミル、ペ

10
10
20
20
30
30
40
40

ップルミル、ローラーミル、アトライターおよびコロイドミルが含まれる。サンドグラインダーミルおよび高速インペラーミルが特に好ましい。また、予備分散処理を実施してもよい。予備分散処理に用いる分散機の例には、ボールミル、三本ロールミル、ニーダーおよびエクストルーダーが含まれる。

【0027】【高屈折率層および中屈折率層の有機化合物からなるポリマー】高屈折率層及び中屈折率層に使用される有機化合物からなるポリマーは、架橋しているアニオン性基を有するポリマーをバインダーとして用いることが好ましい。架橋しているアニオン性基を有するポリマーは、アニオン性基を有するポリマーの主鎖が架橋している構造を有する。アニオン性基は、無機微粒子の分散状態を維持する機能を有する。架橋構造は、ポリマーに皮膜形成能を付与して皮膜を強化する機能を有する。ポリマーの主鎖の例には、ポリオレフィン（飽和炭化水素）、ポリエーテル、ポリウレア、ポリウレタン、ポリエステル、ポリアミン、ポリアミドおよびメラミン樹脂が含まれる。ポリオレフィン主鎖、ポリエーテル主鎖およびポリウレア主鎖が好ましく、ポリオレフィン主鎖およびポリエーテル主鎖がさらに好ましく、ポリオレフィン主鎖が最も好ましい。

【0028】ポリオレフィン主鎖は、飽和炭化水素からなる。ポリオレフィン主鎖は、例えば、不飽和重合性基の付加重合反応により得られる。ポリエーテル主鎖は、エーテル結合（-O-）によって繰り返し単位が結合している。ポリエーテル主鎖は、例えば、エポキシ基の開環重合反応により得られる。ポリウレア主鎖は、ウレア結合（-NH-CO-NH-）によって、繰り返し単位が結合している。ポリウレア主鎖は、例えば、イソシアネート基とアミノ基との縮重合反応により得られる。ポリウレタン主鎖は、ウレタン結合（-NH-CO-O-）によって、繰り返し単位が結合している。ポリウレタン主鎖は、例えば、イソシアネート基と、水酸基（N-メチロール基を含む）との縮重合反応により得られる。ポリエステル主鎖は、エステル結合（-CO-O-）によって、繰り返し単位が結合している。ポリエステル主鎖は、例えば、カルボキシル基（酸ハライド基を含む）と水酸基（N-メチロール基を含む）との縮重合反応により得られる。ポリアミン主鎖は、イミノ結合（-NH-）によって、繰り返し単位が結合している。ポリアミン主鎖は、例えば、エチレンイミン基の開環重合反応により得られる。ポリアミド主鎖は、アミド結合（-NH-CO-）によって、繰り返し単位が結合している。ポリアミド主鎖は、例えば、イソシアネート基とカルボキシル基（酸ハライド基を含む）との反応により得られる。メラミン樹脂主鎖は、例えば、トリアジン基（例、メラミン）とアルデヒド（例、ホルムアルデヒド）との縮重合反応により得られる。なお、メラミン樹脂は、主鎖そのものが架橋構造を有する。

【0029】アニオン性基は、ポリマーの主鎖に直接結合させるか、あるいは連結基を介して主鎖に結合させる。アニオン性基は、連結基を介して側鎖として、主鎖に結合させることが好ましい。アニオン性基の例には、カルボン酸基（カルボキシル）、スルホン酸基（スルホ）およびリン酸基（ホスホノ）が含まれる。スルホン酸基およびリン酸基が好ましい。アニオン性基は、塩の状態であってもよい。アニオン性基と塩を形成するカチオンは、アルカリ金属イオンであることが好ましい。また、アニオン性基のプロトンは、解離していてもよい。アニオン性基とポリマーの主鎖とを結合する連結基は、-CO-、-O-、アルキレン基、アリーレン基、およびこれらの組み合わせから選ばれる二価の基であることが好ましい。架橋構造は、二以上の主鎖を化学的に結合（好ましくは共有結合）する。架橋構造は、三以上の主鎖を共有結合することが好ましい。架橋構造は、-CO-、-O-、-S-、窒素原子、リン原子、脂肪族残基、芳香族残基およびこれらの組み合わせから選ばれる二価以上の基からなることが好ましい。ポリマーは、アニオン性基を有する繰り返し単位と、架橋構造を有する繰り返し単位とを有するコポリマーであることが好ましい。コポリマー中のアニオン性基を有する繰り返し単位の割合は、2乃至96重量%であることが好ましく、4乃至94重量%であることがさらに好ましく、6乃至92重量%であることが最も好ましい。繰り返し単位は、二以上のアニオン性基を有していてもよい。コポリマー中の架橋構造を有する繰り返し単位の割合は、4乃至98重量%であることが好ましく、6乃至96重量%であることがさらに好ましく、8乃至94重量%であることが最も好ましい。

【0030】ポリマーの繰り返し単位は、アニオン性基と架橋構造の双方を有していてもよい。ポリマーには、他の繰り返し単位（アニオン性基も架橋構造もない繰り返し単位）が含まれていてもよい。他の繰り返し単位としては、アミノ基または四級アンモニウム基を有する繰り返し単位およびベンゼン環を有する繰り返し単位が好ましい。アミノ基または四級アンモニウム基は、アニオン性基と同様に、無機微粒子の分散状態を維持する機能を有する。ベンゼン環は、高屈折率層の屈折率を高くする機能を有する。なお、アミノ基、四級アンモニウム基およびベンゼン環は、アニオン性基を有する繰り返し単位あるいは架橋構造を有する繰り返し単位に含まれていても、同様の効果が得られる。

【0031】アミノ基または四級アンモニウム基を有する繰り返し単位では、アミノ基または四級アンモニウム基は、ポリマーの主鎖に直接結合させるか、あるいは連結基を介して主鎖に結合させる。アミノ基または四級アンモニウム基は、連結基を介して側鎖として、主鎖に結合させることが好ましい。アミノ基または四級アンモニウム基は、二級アミノ基、三級アミノ基または四級アン

モニウム基であることが好ましく、三級アミノ基または四級アンモニウム基であることがさらに好ましい。二級アミノ基、三級アミノ基または四級アンモニウム基の窒素原子に結合する基は、アルキル基であることが好ましく、炭素原子数が1乃至12のアルキル基であることが好ましく、炭素原子数が1乃至6のアルキル基であることがさらに好ましい。四級アンモニウム基の対イオンは、ハライドイオンであることが好ましい。アミノ基または四級アンモニウム基とポリマーの主鎖とを結合する連結基は、-CO-、-NH-、-O-、アルキレン基、アリーレン基、およびこれらの組み合わせから選ばれる二価の基であることが好ましい。ポリマーが、アミノ基または四級アンモニウム基を有する繰り返し単位を含む場合、その割合は、0.06乃至32重量%であることが好ましく、0.08乃至30重量%であることがさらに好ましく、0.1乃至28重量%であることが最も好ましい。

【0032】ベンゼン環を有する繰り返し単位では、ベンゼン環は、ポリマーの主鎖に直接結合させるか、あるいは連結基を介して主鎖に結合させる。ベンゼン環は、連結基を介して側鎖として、主鎖に結合させることが好ましい。ベンゼン環は、置換基（例、アルキル基、ヒドロキシ、ハロゲン原子）を有していてもよい。ベンゼン環とポリマーの主鎖とを結合する連結基は、-CO-、-O-、アルキレン基、アリーレン基、およびこれらの組み合わせから選ばれる二価の基であることが好ましい。ポリマーが、ベンゼン環を有する繰り返し単位を含む場合、その割合は、2乃至98重量%であることが好ましく、4乃至96重量%であることがさらに好ましく、6乃至94重量%であることが最も好ましい。

【0033】架橋しているアニオン性基を有するポリマーは、高屈折率層、及び中屈折率層の塗布液（前述した無機微粒子の分散液）にモノマーとして添加し、層の塗布と同時に塗布後に、重合反応によって形成することが好ましい。アニオン性基を有するモノマーは、塗布液中で無機微粒子の分散剤として機能する。アニオン性基を有するモノマーの無機微粒子に対する使用量は、1乃至50重量%の範囲であることが好ましく、5乃至40重量%の範囲であることが好ましく、10乃至30重量%であることが最も好ましい。また、アミノ基または四級アンモニウム基を有するモノマーは、塗布液中で分散助剤として機能する。アミノ基または四級アンモニウム基を有するモノマーのアニオン性基を有するモノマーに対する使用量は、3乃至33重量%であることが好ましい。層の塗布と同時に塗布後に、重合反応によってポリマーを形成すれば、層の塗布前にこれらのモノマーを有効に機能させることができる。

【0034】アニオン性基を有するモノマー、およびアミノ基または四級アンモニウム基を有するモノマーは市販のモノマーを用いてもよい。好ましく用いられる市販

のアニオン性基を有するモノマーとしては、KAYAMAR PM-21、PM-2（日本化薬（株）製）、Antox MS-60、MS-2N、MS-NH4（日本乳化剤（株）製）、アロニックスM-5000、M-6000、M-8000シリーズ（東亜合成化学工業（株）製）、ビスコート#2000シリーズ（大阪有機化学工業（株）製）、ニューフロンティアGX-8289（第一工業製薬（株）製）、NKエステルCB-1、A-SA（新中村化学工業（株）製）、AR-100、MR-100、MR-200（大八化学工業（株）製）などがあげられる。また、好ましく用いられる市販のアミノ基または四級アンモニウム基を有するモノマーとしてはDMAA（大阪有機化学工業（株）製）、DMAEA、DMA PAA（興人（株）製）、ブレンマーQA（日本油脂（株）製）、ニューフロンティアC-1615（第一工業製薬（株）製）などがあげられる。ポリマーの重合反応は、光重合反応または熱重合反応を用いることができる。光重合反応が好ましい。

【0035】光重合反応によりポリマーを形成する場合、酸素濃度が15体積%以下の雰囲気で形成することができる。例えば、光重合性官能基を有する電離放射線硬化性樹脂組成物（多官能モノマーや多官能オリゴマーなど）を含む塗布液を透明支持体上に塗布し、電離放射線硬化性樹脂組成物を光架橋反応、又は、光重合反応させることにより形成することができる。光重合性官能基としては、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、ビニル基、スチリル基、アリル基等の不飽和の重合性官能基等が挙げられ、なかでも、アクリロイルオキシ基が好ましい。

【0036】光重合性官能基をする光重合性多官能モノマーの具体例としては、ネオペンチルグリコールアクリレート、1, 6-ヘキサンジオール（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート等のアルキレングリコールの（メタ）アクリル酸ジエステル類；トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート等のポリオキシアルキレングリコールの（メタ）アクリル酸ジエステル類；ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート等の多価アルコールの（メタ）アクリル酸ジエステル類；2, 2-ビス{4-(アクリロキシ・ジエトキシ)フェニル}プロパン、2, 2-ビス{4-(アクリロキシ・ポリプロポキシ)フェニル}プロパン等のエチレンオキシドあるいはプロピレンオキシド付加物の（メタ）アクリル酸ジエステル類；等を挙げることができる。さらにはエポキシ（メタ）アクリレート類、ウレタン（メタ）アクリレート類、ポリエステル（メタ）アクリレート類も、光重合性多官能モノマーとして、好ましく用いられる。

【0037】なかでも、多価アルコールと（メタ）アクリル酸とのエステル類が好ましい。さらに好ましくは、1分子中に3個以上の（メタ）アクリロイルオキシ基をする多官能モノマーが好ましい。具体的には、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールエタントリ（メタ）アクリレート、1, 2, 4-シクロヘキサンテトラ（メタ）アクリレート、ペンタグリセロールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、（ジ）ペンタエリスリトールトリアクリレート、（ジ）ペンタエリスリトールペンタアクリレート、（ジ）ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、（ジ）ペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、トリペンタエリスリトールトリアクリレート、トリペンタエリスリトールヘキサトリアクリレート等があげられる。

【0038】多官能モノマーは、二種類以上を併用してもよい。光重合性多官能モノマーの重合反応には、光重合開始剤を用いることができる。光重合開始剤としては、光ラジカル重合開始剤と光カチオン重合開始剤が好ましく、特に好ましいのは光ラジカル重合開始剤である。光ラジカル重合開始剤としては、例えば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラーのベンゾイルベンゾエート、 α -アミロキシムエステル、テトラメチルチウラムモノサルファイドおよびチオキサントン類等が挙げられる。市販の光ラジカル重合開始剤としては、日本化薬（株）製のKAYACURE (DETX-S, BP-100, BDMK, CTX, BMS, 2-EAQ, ABQ, CPTX, EPD, ITX, QTX, BTC, MCAなど)、日本チバガイギー（株）製のイルガキュア (651, 184, 500, 907, 369, 1173, 2959, 4265, 4263など)、サートマー社製のEsacure (KIP100F, KB1, EB3, BP, X33, KT046, KT37, KIP150, TZT) 等が挙げられる。

【0039】特に、光開裂型の光ラジカル重合開始剤が好ましい。光開裂型の光ラジカル重合開始剤については、最新UV硬化技術（P. 159, 発行人；高薄一弘, 発行所；（株）技術情報協会, 1991年発行）に記載されている。市販の光開裂型の光ラジカル重合開始剤としては、日本チバガイギー（株）製のイルガキュア (651, 184, 907) 等が挙げられる。光重合開始剤は、多官能モノマー100重量部に対して、0.1～1.5重量部の範囲で使用することができる。光重合開始剤に加えて、光増感剤を用いてもよい。光増感剤の具体例として、n-ブチルアミン、トリエチルアミン、トリー- n -ブチルホスフィン、ミヒラーのケトンおよびチオキサントンを挙げることができる。市販の光増感剤としては、日本化薬（株）製のKAYACURE (DMB I,

EPA) などが挙げられる。

【0040】ポリマーを、酸素濃度が15体積%以下の雰囲気で形成することにより、高屈折率層、及び、中屈折率層の物理的強度（耐摩耗性など）、耐薬品性を改良することができる。好ましくは、酸素濃度が6体積%以下の雰囲気で架橋反応、又は、重合反応によりポリマーを形成することであり、更に好ましくは、酸素濃度が3体積%以下、特に好ましくは酸素濃度が2体積%以下である。

【0041】酸素濃度を15体積%以下にする手法としては、大気（窒素濃度約79体積%、酸素濃度約21体積%）を別の気体で置換することが好ましく、特に好ましくは窒素で置換（窒素ページ）することである。光重合反応によりポリマーを形成する場合、光源として低压水銀ランプ、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ、ケミカルランプあるいはメタルハライドランプを用いることができる。照射効率が良好な高圧水銀ランプの使用が、最も好ましい。塗布液（モノマーを含む無機微粒子の分散液）を加熱して、モノマー（またはオリゴマー）の重合を促進してもよい。また、塗布後の光重合反応の後に加熱して、形成されたポリマーの熱硬化反応を追加処理してもよい。アニオン性基を有するポリマーは、架橋しているため分子量の規定は困難である。高屈折率層、及び中屈折率層に含まれる架橋しているアニオン性基を有するポリマーの割合は、35乃至95体積%である。好ましくは40乃至90体積%、更に好ましくは45乃至80体積%である。

【0042】重合反応および架橋反応に使用する光重合開始剤の例には、アセトフェノン類、ベンゾイン類、ベンゾフェノン類、ホスフィンオキシド類、ケタール類、アントラキノン類、チオキサントン類、アゾ化合物、過酸化物類、2, 3-ジアルキルジオン化合物類、ジスルフィド化合物類、フルオロアミン化合物類や芳香族スルホニウム類がある。アセトフェノン類の例には、2, 2-ジエトキシアセトフェノン、p-ジメチルアセトフェノン、1-ヒドロキシジメチルフェニルケトン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチル-4-メチルチオ-2-モルフォリノプロピオフェノンおよび2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル)-ブタノンが含まれる。ベンゾイン類の例には、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテルおよびベンゾインイソプロピルエーテルが含まれる。ベンゾフェノン類の例には、ベンゾフェノン、2, 4-ジクロロベンゾフェノン、4, 4-ジクロロベンゾフェノンおよびp-クロロベンゾフェノンが含まれる。ホスフィンオキシド類の例には、2, 4, 6-トリメチルベンゾイルジフェニルfosfifinオキシドが含まれる。

【0043】市販の重合開始剤を使用してもよい。重合開始剤に加えて、重合促進剤を使用してもよい。重合開

10 熱して、形成されたポリマーの熱硬化反応を追加処理してもよい。アニオン性基を有するポリマーは、架橋しているため分子量の規定は困難である。高屈折率層中の架橋しているアニオン性基を有するポリマーの割合は、35乃至95体積%である。好ましくは40乃至90体積%、更に好ましくは45乃至80体積%である。

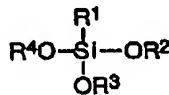
【0044】[高屈折率層および中屈折率層] 図3は、高屈折率層(1)（又は中屈折率層）の断面模式図である。図3の高屈折率層(1)の上側に低屈折率層があり、下側に画像表示装置またはレンズがある。図3に示すように、高屈折率層(1)は、空孔がなく、無機微粒子(11)の間にポリマー(12)が充填されている層である。高屈折率層(1)内では、平均粒径が1乃至200nmの無機微粒子(11)が（図3では3個）積み重なっている。そして、無機微粒子(11)の間に、有機化合物からなるポリマー(12)が充填されている。有機化合物からなるポリマー(12)は架橋しているアニオン性基を有するポリマーが好ましい。高屈折率層の屈折率は、1.65乃至2.40であることが好ましい。屈折率は、1.70乃至2.20であることがさらに好ましい。中屈折率層の屈折率は、1.65乃至1.85であることが好ましい。1.65乃至1.75であることがさらに好ましい。屈折率は、アッペル屈折率計を用いる測定や、層表面からの光の分光反射率の測定から得られる分光反射率曲線の形状から求めることができる。高屈折率層、及び中屈折率層の厚さは、5nm乃至200nmであることが好ましく、10nm乃至150nmであることがさらに好ましく、30nm乃至100nmであることが最も好ましい。高屈折率層、及び中屈折率層のヘイズは、5%以下であることが好ましく、3%以下であることがさらに好ましく、1%以下であることが最も好ましい。高屈折率層、及び中屈折率層の強度は、JIS K5400に従う鉛筆硬度試験で、H以上であることが好ましく、2H以上であることがさらに好ましく、3H以上であることが最も好ましい。

【0045】[低屈折率層の無機微粒子] 無機微粒子の平均粒径は、0.5乃至200nmである。粒子径が増大すると前方散乱が増加し、200nmを越えると散乱光に色付きが生じる。平均粒径は、1乃至100nmであることが好ましく、3乃至70nmであることがさら 50 に好ましく、5乃至40nmの範囲であることが最も好

まい。無機微粒子の粒径分布は、なるべく狭い（単分散）ほうが好ましい。無機微粒子は、非晶質であることが好ましい。無機微粒子は、金属の酸化物から形成することが好ましい。金属原子としては、Na、K、Mg、Ca、Ba、Al、Zn、Fe、Cu、Ti、Sn、In、W、Y、Sb、Mn、Ga、V、Nb、Ta、Ag、Si、B、Bi、Mo、Ce、Cd、Be、PbおよびNiが好ましく、Al、Sn、Fe、In、Ti、Zn、ZrおよびSiがさらに好ましい。特に、Siが好ましい。二種類以上の金属を含む無機化合物を用いてもよい。

【0046】[低屈折率層の無機粒子間の微細な空隙] 図4は、好ましい低屈折率層の断面模式図である。図4の反射防止膜の上側が表面であり、下側に画像表示装置またはレンズがある。図4に示すように、低屈折率層(2)には無機微粒子(21)の粒子間に微細な空隙(23)が形成されている。低屈折率層(2)は、さらにポリマー(22)を5～50重量%の量で含む。ポリマー(22)は、無機微粒子(21)を接着しているが、粒子間の空隙(23)を充填していない。図4に示すように、粒子間の空隙(23)は、ポリマー(22)と無機微粒子(21)により閉じている(開口ではない)ことが好ましい。低屈折率層の空隙率は、1～50体積%であり、好ましくは3～45体積%、更に好ましくは5～35体積%である。空隙率を増加させると、低屈折率層の屈折率が低下する。本発明では、無機微粒子の粒径を調整することで、粒子間の微細な空隙の大きさも適度の(光を散乱させず、低屈折率層の強度に問題を生じない)値に容易に調節できる。これにより、低屈折率層は微視的には微細な空隙を含有する多孔質膜であるが、光学的あるいは巨視的には均一な膜にできる。微細な空隙を形成することにより、低屈折率層の巨視的屈折率は、低屈折率層を構成する微粒子とポリマーとの屈折率の総和よりも低い値になる。層の屈折率は、層の構成要素の体積当たりの屈折率の和になる。微粒子とポリマーの屈折率は1よりも大きな値であるのに対し、空気の屈折率は1.00である。そのため、微細な空隙を形成することによって、屈折率が非常に低い低屈折率層を得ることができる。粒子間の微細な空隙 *

(Ia)



* は、無機微粒子およびポリマーによって低屈折率層内で閉じていることが好ましい。閉じている空隙は、低屈折率層表面に開かれた開口と比較して、低屈折率層の表面に汚れが付着しにくい利点がある。

【0047】[低屈折率層のポリマー] 図4に示す好ましい低屈折率層では、低屈折率層は、5乃至50重量%の量のポリマーを含む。ポリマーは、無機微粒子を接着し、粒子間の微細な空隙を含む低屈折率層の構造を維持する機能を有する。ポリマーの使用量は、空隙を充填することなく低屈折率層の強度を維持できるように調整する。ポリマーの量は、低屈折率層の全量の10乃至50重量%が好ましく、更に好ましくは10乃至40重量%、特に好ましくは10乃至30重量%である。ポリマーで無機微粒子を接着するためには、(1)無機微粒子の表面処理剤にポリマーを結合させるか、あるいは

(2)無機微粒子間のバインダーとして、ポリマーを使用することが好ましい。(1)の表面処理剤に結合させるポリマーは、(2)のバインダーポリマーであることが好ましい。(2)のポリマーは、低屈折率層の塗布液にモノマーを添加し、低屈折率層の塗布と同時または塗布後に、重合反応により形成することが好ましい。

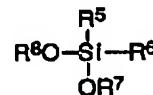
(1)と(2)を組み合わせて、実施することが好ましい。(1)表面処理および(2)バインダーについて、順次説明する。

【0048】(1)表面処理 無機微粒子には、表面処理を実施して、ポリマーとの親和性を改善することが好ましい。表面処理は、プラズマ放電処理やコロナ放電処理のような物理的表面処理と、カップリング剤を使用する化学的表面処理に分類できる。化学的表面処理のみ、または物理的表面処理と化学的表面処理の組み合わせで実施することが好ましい。カップリング剤としては、オルガノアルコキシメタル化合物(例、チタンカップリング剤、シランカップリング剤)が好ましく用いられる。無機微粒子が二酸化ケイ素からなる場合は、シランカップリング剤による表面処理が特に有効に実施できる。好ましいシランカップリング剤を、下記式(Ia)および(Ib)で示す。

【0049】

【化1】

(Ib)



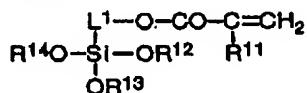
に、炭素原子数が1乃至6のアルキル基または炭素原子数が2乃至6のアシル基である。式(Ia)および式(Ib)において、R¹、R⁵およびR⁶は、アルキル基、アリール基、アルケニル基またはアラルキル基であることが好ましく、アルキル基、アリール基またはアルケニル基であることがさらに好ましく、アルキル基また

【0050】式中、R¹、R⁵およびR⁶は、それぞれ独立に、炭素原子数が1乃至10のアルキル基、炭素原子数が6乃至10のアリール基、炭素原子数が2乃至10のアルケニル基、炭素原子数が2乃至10のアルキニル基または炭素原子数が7乃至10のアラルキル基であり、R²、R³、R⁴、R⁷およびR⁸は、それぞれ独立

はアルケニル基であることが最も好ましい。アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基およびアラルキル基は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、グリシル基、グリシルオキシ基、アルコキシ基、ハロゲン原子、アシルオキシ基（例、アクリロイルオキシ、メタクリロイルオキシ）、メルカプト、アミノ、カルボキシル、シアノ、イソシアナートおよびアルケニルスルホニル基（例、ビニルスルホニル）が含まれる。

【0051】式(I a)および式(I b)において、R²、R³、R⁴、R⁷およびR⁸は、アルキル基であること*

(IIa)



【0053】式中、R¹¹およびR¹⁵は、それぞれ独立に、水素原子またはメチルであり、R¹⁶は、炭素原子数が1乃至10のアルキル基、炭素原子数が6乃至10のアリール基、炭素原子数が2乃至10のアルケニル基、炭素原子数が2乃至10のアルキニル基または炭素原子数が7乃至10のアラルキル基であり、R¹²、R¹³、R¹⁴、R¹⁷およびR¹⁸は、それぞれ独立に、炭素原子数が1乃至6のアルキル基または炭素原子数が2乃至6のアシル基であり、L¹およびL²は二価の連結基である。式(I b)において、R¹⁶は、式(I a)および式(I b)のR¹、R⁵およびR⁶と同様の定義を有する。式(II a)式(II b)において、R¹²、R¹³、R¹⁴、R¹⁷およびR¹⁸は、式(I a)および式(I b)のR²、R³、R⁴、R⁷およびR⁸と同様の定義を有する。式(II a)式(II b)において、L¹およびL²は、アルキレン基であることが好ましく、炭素原子数が1乃至10のアルキレン基であることがさらに好ましく、炭素原子数が1乃至6のアルキレン基であることが最も好ましい。

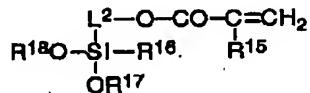
【0054】式(I a)で示されるシランカップリング剤の例には、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリメトキシエトキシシラン、メチルトリアセトキシシラン、メチルトリブトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニルトリメトキシエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェルトリアセトキシシラン、 γ -クロロプロピルトリメトキシシラン、 γ -クロロプロピルトリエトキシシラン、 γ -クロロプロピルトリエトキシシラン、3,3,3-トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシジルオキシプロピルエトキシシラン、 γ -（ β -グリシジルオキシエトキシ）プロピルトリメトキシシラン、 β -（3,4-エポ

*が好ましい。アルキル基は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、アルコキシ基が含まれる。シランカップリング剤は、分子内に二重結合を有し、その二重結合の反応によりポリマーと結合させることが好ましい。二重結合は、式(I a)と式(I b)のR¹、R⁵またはR⁶の置換基中に存在していることが好ましい。特に好ましいシランカップリング剤を、下記式(II a)および(II b)で示す。

【0052】

【化2】

(IIb)



キシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、 β -（3,4-エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン、 γ -アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリエトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリエトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリエトキシシラン、N- β -（アミノエチル）- γ -アミノプロピルトリメトキシシランおよび β -シアノエチルトリエトキシシランが含まれる。

【0055】式(I b)で示されるシランカップリング剤の例には、ジメチルジメトキシシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシジルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシジルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -グリシジルオキシプロピルフェニルジエトキシシラン、 γ -クロロプロピルメチルジエトキシシラン、ジメチルジアセトキシシラン、 γ -アクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -アクリロイルオキシプロピルジエトキシシラン、 γ -メタクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -メタクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -メタクリロイルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -アミノプロピルメチルジエトキシシラン、メチルビニルジメトキシシランおよびメチルビニルジエトキシシランが含まれる。

【0056】分子内に二重結合を有する γ -アクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -アクリロイルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -メタクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -メタクリロイルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、メチルビニルジメトキシシランおよびメチルビニ

ルジエトキシシランが好ましく、式(IIb)で示される γ -アクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -アクリロイルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -メタクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシランおよび γ -メタクリロイルオキシプロピルメチルジエトキシシランが特に好ましい。

【0057】二種類以上のカップリング剤を併用してもよい。式(Ia)および式(Ib)で示されるシランカップリング剤に加えて、他のシランカップリング剤を用いてもよい。他のシランカップリング剤には、オルトケイ酸のアルキルエステル(例、オルトケイ酸メチル、オルトケイ酸エチル、オルトケイ酸n-プロピル、オルトケイ酸i-プロピル、オルトケイ酸n-ブチル、オルトケイ酸sec-ブチル、オルトケイ酸t-ブチル)およびその加水分解物が含まれる。カップリング剤による表面処理は、無機微粒子の分散物に、カップリング剤を加え、室温から60°Cまでの温度で、数時間から10日間分散物を放置することにより実施できる。表面処理反応を促進するため、無機酸(例、硫酸、塩酸、硝酸、クロム酸、次亜塩素酸、ホウ酸、オルトケイ酸、リン酸、炭酸)、有機酸(例、酢酸、ポリアクリル酸、ベンゼンスルホン酸、フェノール、ポリグルタミン酸)、またはこれらの塩(例、金属塩、アンモニウム塩)を分散物に添加してもよい。また、加熱処理してもよい。

【0058】(2) バインダー

バインダーポリマーは、飽和炭化水素またはポリエーテルを主鎖として有するポリマーであることが好ましく、飽和炭化水素を主鎖として有するポリマーであることがさらに好ましい。バインダーポリマーは架橋していることが好ましい。飽和炭化水素を主鎖として有するポリマーは、エチレン性不飽和モノマーの重合反応により得ることが好ましい。架橋しているバインダーポリマーを得るためにには、二以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーを用いることが好ましい。

【0059】二以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの例には、多価アルコールと(メタ)アクリル酸とのエステル(例、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,4-シクロヘキサンジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールエタントリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、1,2,3-シクロヘキサンテトラメタクリレート、ポリウレタンポリアクリレート、ポリエステルポリアクリレート、ビニルベンゼンおよびその誘導体(例、1,4-ジビニルベンゼン、4-ビニル安息香酸-2-アクリロイルエチルエステル、1,4-ジビニルシクロヘキサン)、ビニルス

ルホン(例、ジビニルスルホン)、アクリルアミド(例、メチレンビスアクリルアミド)およびメタクリルアミドが含まれる。ポリエーテルを主鎖として有するポリマーは、多官能エポシキ化合物の開環重合反応により合成することが好ましい。二以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの代わりまたはそれに加えて、架橋性基の反応により、架橋構造をバインダーポリマーに導入してもよい。架橋性官能基の例には、イソシアナート基、エポキシ基、アジリジン基、オキサゾリン基、アルデヒド基、カルボニル基、ヒドラジン基、カルボキシル基、メチロール基および活性メチレン基が含まれる。ビニルスルホン酸、酸無水物、シアノアクリレート誘導体、メラミン、エーテル化メチロール、エステルおよびウレタンも、架橋構造を導入するためのモノマーとして利用できる。ブロックイソシアナート基のように、分解反応の結果として架橋性を示す官能基を用いてもよい。

【0060】また、本発明において架橋基とは、上記化合物に限らず上記官能基が分解した結果反応性を示すものであってもよい。バインダーポリマーは、低屈折率層の塗布液にモノマーを添加し、低屈折率層の塗布と同時に塗布後に重合反応(必要ならばさらに架橋反応)により形成することが好ましい。重合反応のため、重合開始剤を使用することが好ましい。例えば、前述した熱重合開始剤、及び光重合開始剤が挙げられる。バインダーポリマーの重合反応は、光重合反応が好ましい。光重合反応によりバインダーポリマーを形成する場合、酸素濃度が15体積%以下の雰囲気で形成することが好ましい。バインダーポリマーを、酸素濃度が15体積%以下の雰囲気で形成することにより、低屈折率層の物理的強度(耐摩耗性など)、耐薬品性を改良することができる。好ましくは、酸素濃度が6体積%以下の雰囲気でモノマーの架橋反応、又は、重合反応により形成することであり、更に好ましくは酸素濃度が3体積%以下、特に好ましくは酸素濃度が2体積%以下である。酸素濃度を15体積%以下にする手法としては、大気(窒素濃度約79体積%、酸素濃度約21体積%)を別の気体で置換することが好ましく、特に好ましくは窒素で置換(窒素バージ)することである。低屈折率層の塗布液に、少量のポリマー(例、ポリビニルアルコール、ポリオキシエチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース、ニトロセルロース、ポリエステル、アルキド樹脂)を添加してもよい。

【0061】【低屈折率層】低屈折率層は、上記の無機微粒子およびポリマーを含み、粒子間に微細な空隙を有する層であることが好ましい。低屈折率層の屈折率は、1.30乃至1.55であることが好ましく、1.35乃至1.50であることがさらに好ましい。低屈折率層の膜厚は、30nm乃至200nmであることが好ましく、50nm乃至150nmであることがさらに好まし

く、60nm乃至120nmであることが最も好ましい。低屈折率層のヘイズは、5%以下であることが好ましく、3%以下であることがさらに好ましく、1%以下であることが最も好ましい。低屈折率層の強度は、JIS K5400に従う鉛筆硬度試験で、H以上であることが好ましく、2H以上であることがさらに好ましく、3H以上であることが最も好ましい。

【0062】[透明支持体] 反射防止膜をCRT画像表示面やレンズ表面に直接設ける場合を除き、反射防止膜は透明支持体を有することが好ましい。透明支持体としては、プラスチックフィルムを用いることが好ましい。プラスチックフィルムの材料の例には、セルロースエステル（例、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、プロピオニルセルロース、ブチリルセルロース、アセチルプロピオニルセルロース、ニトロセルロース）、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリエステル（例、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリ-1,4-シクロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポリエチレン-1,2-ジフェノキシエタン-4,4-ジカルボキシレート、ポリブチレンテレフタレート）、ポリスチレン（例、シンジオタクチックポリスチレン）、ポリオレフィン（例、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン）、ポリスルホン、ポリエテルスルホン、ポリアリレート、ポリエーテルイミド、ポリメチルメタクリレートおよびポリエーテルケトンが含まれる。トリアセチルセルロース、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレートおよびポリエチレンナフタレートが好ましく用いられ、特に好ましいのはトリアセチルセルロースである。

【0063】本発明では、ソルベントキャスト法により、製造されたトリアセチルセルロースが好ましく、トリアセチルセルロースを有機溶媒に溶解した溶液（ドープ）を用いて製造される。本発明の主溶媒として好ましく用いられる有機溶媒は、炭素原子数が3～12のエーテル、炭素原子数が3～12のケトン、炭素原子数が3～12のエステルおよび炭素原子数が1～7のハロゲン化炭素から選ばれる溶媒を含むことが好ましい。エーテル、ケトンおよびエステルは、環状構造を有してもよい。エーテル、ケトンおよびエステルの官能基（すなわち、-O-、-CO-および-COO-）のいずれかを二つ以上有する化合物も、有機溶媒として用いることができる。有機溶媒は、アルコール性水酸基のような他の官能基を有していてもよい。二種類以上の官能基を有する有機溶媒の場合、その炭素原子数は、いずれかの官能基を有する化合物の規定範囲内であればよい。

【0064】本発明では、調製したドープを用いて2層以上の流延でフィルム化すべく、ソルベントキャスト法により作製される。ドープは、ドラムまたはバンド上に流延し、溶媒を蒸発させてフィルムを形成する。流延前のドープは、固形分量が10～40%となるように濃度

を調整することが好ましい。ドラムまたはバンドの表面は、鏡面状態に仕上げておくことが好ましい。

【0065】複数のドープを流延する場合、支持体の進行方向に間隔を置いて設けた複数の流延口からドープをそれぞれ流延させて積層させながらフィルムを作製してもよく、例えば特開昭61-158414号、特開平1-122419号、特開平11-198285号、などに記載の方法が適応できる。また、2つの流延口からドープを流延することによってもフィルム化することでもよく、例えば特公昭60-27562号、特開昭61-94724号、特開昭61-947245号、特開昭61-104813号、特開昭61-158413号、特開平6-134933号、に記載の方法で実施できる。また、特開昭56-162617号に記載の高粘度ドープの流れを低粘度のドープで包み込み、その高、低粘度のドープを同時に押出す流延方法でもよい。

【0066】或いはまた2個の流延口を用いて、第一の流延口により支持体に成型したフィルムを剥ぎ取り、支持体面に接していた側に第二の流延を行うことにより、フィルムを作製することでもよく、例えば特公昭44-20235号に記載されている方法である。流延するドープは同一の溶液でもよいし、異なるドープでもよく特に限定されない。複数の層に機能を持たせるために、その機能に応じたドープを、それぞれの流延口から押出せばよい。さらに本発明に使用するドープは、他の機能層（例えば、接着層、染料層、帯電防止層、アンチハレーション層、UV吸収層、偏光層など）を同時に流延することも実施しうる。

【0067】鹹化処理したトリアセチルセルロースフィルムも好ましく用いることができる。透明支持体の膜厚は1～300μmがよく、好ましくは30～150μm、特に好ましくは50～120μmである。透明支持体の光透過率は、80%以上であることが好ましく、86%以上であることがさらに好ましい。透明支持体のヘイズは2.0%以下であることが好ましく、1.0%以下であることがさらに好ましい。透明支持体の屈折率は、1.4乃至1.7であることが好ましい。

【0068】光重合開始剤は、多官能モノマー100重量部に対して、0.1乃至1.5重量部の範囲で使用することが好ましく、1乃至1.0重量部の範囲で使用することがさらに好ましい。光重合反応は、ハードコート層の塗布および乾燥後、紫外線照射により実施することが好ましい。ハードコート層には、充填剤を添加することが好ましい。充填剤はハードコート層の硬度を高くし、多官能モノマーの硬化収縮を抑える機能がある。充填剤としては、無機微粒子または有機微粒子を用いることが好ましい。無機微粒子の例には、二酸化ケイ素粒子、二酸化チタン粒子、酸化ジルコニウム粒子、酸化アルミニウム粒子、酸化錫粒子、炭酸カルシウム粒子、硫酸バリウム粒子、タルク、カオリיןおよび硫酸カルシウム粒子が

含まれる。有機微粒子の例には、メタクリル酸-メチルアクリレートコポリマー、シリコン樹脂、ポリスチレン、ポリカーボネート、アクリル酸-ステチレンコポリマー、ベンゾグアニン樹脂、メラミン樹脂、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミドおよびポリフッ化エチレンが含まれる。充填剤として使用する微粒子の平均粒子径は、0.01乃至2μmであることが好ましく、0.02乃至0.5μmであることがさらに好ましい。ハードコート層またはその塗布液には、さらに、着色剤（顔料、染料）、消泡剤、増粘剤、レベリング剤、難燃剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤や改質用樹脂を添加してもよい。ハードコート層の厚さは、1乃至15μmであることが好ましい。ハードコートの強度は、JIS K5400に従う鉛筆硬度試験で、H以上であることが好ましく、2H以上であることがさらに好ましく、3H以上であることが最も好ましい。

【0069】オーバーコート層は、含フッ素化合物を含む塗布液を、低屈折率層の上に塗布して形成する。本発明では、オーバーコート層の材料が低屈折率層の空隙を占有している割合を70体積%未満とする。オーバーコート層の材料が低屈折率層の空隙を占有している割合は、50体積%未満であることが好ましく、40体積%未満であることがより好ましく、30体積%未満であることがさらに好ましく、20体積%未満であることが最も好ましい。オーバーコート層に用いる含フッ素化合物の屈折率は、1.35~1.50であることが好ましい。より好ましくは1.36~1.47、さらに好ましくは1.38~1.45である。また、含フッ素化合物はフッ素原子を35~80重量%の範囲で含むことが好ましく、45~75重量%の範囲で含むことがさらに好ましい。含フッ素化合物には、含フッ素ポリマー、含フッ素シラン化合物、含フッ素界面活性剤、含フッ素エーテルなどが挙げられる。

【0070】【オーバーコート層】図5は、本発明の好ましい態様における低屈折率層（2）とオーバーコート層（6）の断面模式図である。低屈折率層（2）には、無機微粒子（21）およびポリマー（22）がふくまれ、粒子間に空隙（23）が形成されている。図5

（a）のオーバーコート層（6）は、含フッ素化合物の微粒子（61）を含む。含フッ素化合物の微粒子（61）により、低屈折率層（2）の空隙（23）の開口が塞がれるため、オーバーコート層（6）形成後も、低屈折率層（2）の空隙（23）が維持されている。図5（b）のオーバーコート層（6）は、低屈折率層（2）の空隙をすべて埋めてしまわない程度にオーバーコート層の素材の塗布量が調整されている。そのため、オーバーコート層（6）の形成後も、低屈折率層（2）の空隙（23）が維持されている。図5（c）は本発明の最も好ましい態様における低屈折率層とオーバーコート層の断面模式図である。オーバーコート層（6）は重量平均

分子量2万以上の含フッ素ポリマーからなり、低屈折率層の表面の凹凸は覆うが、低屈折率層内部の空隙（23）には侵入しない。従って、オーバーコート層（6）の形成後も、低屈折率層（2）の空隙（23）が維持される。この態様の場合、オーバーコート層（6）の塗布量を低屈折率層（2）の空隙（23）の容積以上に塗布しても空隙が維持される。そのため、図5（c）に示す態様では、オーバーコート層（6）が連続層として、低屈折率層（2）の表面を覆っている。

10 【0071】オーバーコート層は、含フッ素化合物を含む塗布液を、低屈折率層の上に塗布して形成する。本発明では、オーバーコート層の材料が低屈折率層の空隙を占有している割合を70体積%未満とする。オーバーコート層の材料が低屈折率層の空隙を占有している割合は、50体積%未満であることが好ましく、40体積%未満であることがより好ましく、30体積%未満であることがさらに好ましく、20体積%未満であることが最も好ましい。オーバーコート層に用いる含フッ素化合物は、フッ素原子を35乃至80重量%の範囲で含むことが好ましく、45乃至75重量%の範囲で含むことがさらに好ましい。含フッ素化合物としては、含フッ素界面活性剤、含フッ素ポリマー、含フッ素エーテルや含フッ素シラン化合物が好ましく用いられる。

20 【0072】含フッ素ポリマーとしては、フッ素を含むエチレン性不飽和モノマーの架橋反応、又は、重合反応により合成されたものが挙げられる。フッ素原子を含むエチレン性不飽和モノマーの例には、フルオロオレフィン（例、フルオロエチレン、ビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロー2,2-ジメチル-1,3-ジオキソール）、フッ素化ビニルエーテルおよびフッ素置換アルコールとアクリル酸またはメタクリル酸とのエステルが含まれる。含フッ素ポリマーとしてフッ素原子を含む繰り返し単位とフッ素原子を含まない繰り返し構造単位からなる共重合体も用いることができる。上記共重合体は、フッ素原子を含むエチレン性不飽和モノマーとフッ素原子を含まないエチレン性不飽和モノマーの重合反応により得ることができる。フッ素原子を含まないエチレン性不飽和モノマーとしては、オレフィン（例、エチレン、プロピレン、イソブレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン等）、アクリル酸エステル（例、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル等）、メタクリル酸エステル（例、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、エチングリコールジメタクリレート等）、スチレンおよびその誘導体（例、スチレン、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、α-メチルスチレン等）、ビニルエーテル（例、メチルビニルエーテル等）、ビニルエステル（例、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、桂皮酸ビニル等）、アクリルアミド（例、N-tert-ブチルアクリ

リルアミド、N-シクロヘキシルアクリルアミド等)、メタクリルアミドおよびアクリロニトリルが挙げられる。含フッ素シラン化合物としては、パーフルオロアルキル基を含むシラン化合物(例、ヘプタデカフルオロー1, 2, 2, 2-テトラデシル)トリエトキシシラン等)が挙げられる。含フッ素界面活性剤は、その親水性部分がアニオン性、カチオン性、ノニオン性および両性のいずれであってもよい。そして疎水性部分を構成する炭化水素の水素原子の一部または全部が、フッ素原子により置換されている。

【0073】含フッ素エーテルは、一般に潤滑剤として使用されている化合物である。含フッ素エーテルとしては、パーフルオロポリエーテル等が挙げられる。オーバーコート層には、架橋構造が導入された含フッ素ポリマーを用いることが特に好ましい。架橋構造が導入された含フッ素ポリマーは、架橋性基、又は、重合性基を有する含フッ素ポリマーを架橋、又は、重合させることにより得られる。架橋性基、又は、重合性基を有する含フッ素ポリマーは、架橋性基、又は、重合性基を有さない含フッ素ポリマーに架橋性基、又は、重合性基を側鎖として導入することにより得ることができる。架橋性基、又は、重合性基としては、光、好ましくは、紫外線照射、電子ビーム(EB)照射あるいは加熱により反応して含フッ素ポリマーが架橋構造を有するようになる官能基であることが好ましい。架橋性基、又は、重合性基としては、アクリロイル、メタクリロイル、イソシアナート、エポキシ、アジリジン、オキサゾリン、アルデヒド、カルボニル、ヒドラジン、カルボキシル、メチロールおよび活性メチレン等の基が挙げられる。架橋性基、又は、重合性基を有する含フッ素ポリマーとして、市販品を用いてもよい。オーバーコート層は、含フッ素化合物以外に充填剤(例えば、無機微粒子や有機微粒子等)、滑り剤(ジメチルシリコンなどのシリコン化合物等)、界面活性剤等を含有することができる。オーバーコート層は、含フッ素化合物、その他所望により含有される任意成分を溶解あるいは分散させた塗布液を塗布と同時に、または塗布後に光照射、電子線ビーム照射や加熱することによる架橋反応、又は、重合反応により形成することができる。オーバーコート層の膜厚は、3~50nmが好ましく、より好ましくは5~35nm、特に好ましくは7~25nmである。

【0074】【反射防止膜】反射防止膜の反射率は低いほど好ましい。具体的には450乃至650nmの波長領域での平均反射率が2%以下であることが好ましく、1%以下であることがさらに好ましく、0.7%以下であることが最も好ましい。反射防止膜のヘイズは3%以下であることが好ましく、1%以下であることがさらに好ましく、0.5%以下であることが最も好ましい。反射防止膜は、物理的強度(耐摩耗性など)を改良するために、低屈折率層を有する側の表面の動摩擦係数は0.

10 25以下であることが好ましい。ここで記載した動摩擦係数は、ステンレス剛球に100gの荷重をかけ、速度60cm/分で低屈折率層を有する側の表面を移動させたときの、低屈折率層を有する側の表面と直径5mmのステンレス剛球の間の動摩擦係数をいう。好ましくは0.17以下であり、特に好ましくは0.15以下である。反射防止膜の強度は、JISK5400に従う鉛筆硬度試験で、H以上であることが好ましく、2H以上であることがさらに好ましく、3H以上であることが最も好ましい。また、反射防止膜は、防汚性能を改良するために、低屈折率層を有する側の表面の、水に対する接触角が90°以上であることが好ましい。更に好ましくは95°以上であり、特に好ましくは100°以上である。動摩擦係数、水に対する接触角は、本発明の反射防止膜を偏光板に適用した後も保たれていることが好ましい。反射防止膜は、外光を散乱させる防眩機能を有しているよい。防眩機能は、反射防止膜の表面に凹凸を形成することにより得られる。例えば、低屈折率層、高屈折率層、中屈折率層あるいはハードコート層に比較的大きな粒子(例えば平均粒径が1~5mの粒子)を少量(添加する層に対し0.1~50重量%)添加してもよい。反射防止膜が防眩機能を有する場合、反射防止膜のヘイズは、3乃至30%であることが好ましく、5乃至20%であることがさらに好ましく、7乃至20%であることが最も好ましい。

【0075】【反射防止膜の形成法等】反射防止膜には、以上述べた以外の層を設けてもよい。例えば透明支持体の上には、ハードコート層に加えて接着層、シールド層、滑り層や帶電防止層を設けてもよい。シールド層は電磁波や赤外線を遮蔽するために設けられる。反射防止膜の各層またはその塗布液には、前述した成分(無機微粒子、ポリマー、分散媒体、重合開始剤、重合促進剤)以外に、重合禁止剤、レベリング剤、増粘剤、着色防止剤、紫外線吸収剤、シランカップリング剤、帶電防止剤や接着付与剤を添加してもよい。レベリング剤の例にはフッ素化アルキルエステル(例えば、住友3M(株)のFC-430、FC-431、以上商品名)およびポリシロキサン(例えば、General Electric(株)のSF1023、SF1054、SF1079、Dow Corning(株)のDC190、DC200、DC510、DC1248、BYK Chemie(株)のBYK300、BYK310、BYK320、BYK322、BYK330、BYK370、以上商品名)が含まれる。反射防止膜の各層は、ディップコート法、エアーナイフコート法、カーテンコート法、ローラーコート法、ワイヤバーコート法、グラビアコート法やエクストルージョンコート法(米国特許2681294号明細書記載)により、塗布により形成することができる。二層以上を同時に塗布してもよい。同時塗布の方法については、米国特許2761791号、同2941898号、同350894

7号、同3526528号の各明細書および原崎勇次著、コーティング工学、253頁、朝倉書店(1973)に記載がある。

【0076】[画像表示装置]反射防止膜は、液晶表示装置(LCD)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、エレクトロルミネッセンスディスプレイ(ELD)や陰極管表示装置(CRT)のような画像表示装置に適用する。反射防止膜は、反射防止膜の透明支持体側を画像表示装置の画像表示面に接着する。

【0077】図6は本発明の反射防止膜を画像表示装置に適用する様々な態様を模式的に示す概略断面図である。図6(a)は、反射防止膜をPDP、ELD、CRTに適用する好ましい態様である。反射防止膜は、透明支持体(3)を粘着剤層(イ)を介して画像表示装置の画像表示面に接着している。図6(b)、(c)及び(d)は、反射防止膜をLCDに適用する好ましい態様である。図6(b)では、反射防止膜は透明支持体(3)が粘着剤層(イ)を介して偏光板保護膜(ロー1)に接着しており、もう一方の偏光板保護膜(ロー2)を粘着剤層(イ)を介して画像表示装置の画像表示面に接着している。図6(c)では、反射防止膜は透明支持体(3)が粘着剤層(イ)を介して偏光板(ハ)に接着しており、偏光板保護膜(ロー2)を粘着剤層(イ)を介して画像表示装置の画像表示面に接着している。図6(d)では、反射防止膜は透明支持体(3)が直接偏光板(ハ)に接着しており、偏光板保護膜(ロー2)側を粘着剤層(イ)を介して画像表示装置の画像表示面に接着している。粘着剤層(イ)には、粒子、染料などの添加剤を添加してもよい。

【0078】

【実施例】以下実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【実施例1】

(ハードコート層用塗布液の調製)市販のハードコート材料(デソライトZ7503、JSR(株)製)のメチルエチルケトン溶液(固形分濃度:72重量%、シリカ含有量:38重量%)625gに、メチルエチルケトン155.0gとシクロヘキサン220.0gを添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してハードコート層の塗布液を調製した。

【0079】(二酸化チタン微粒子分散液の調製)コア/シェル構造の二酸化チタン微粒子(TTO-55B、シェル材料;アルミナ(粒子全体の9重量%)、石原産業(株)製)30.0重量部、市販のアニオン性モノマー(PM-21、日本化薬(株)製)4.5重量部、市販のカチオン性モノマー(DMAEA、(株)興人)0.3重量部およびシクロヘキサン65.2重量部を、サンドグラインダーミルにより分散し、重量平均径53nmの二酸化チタン分散液を調製した。

【0080】(中屈折率層用塗布液の調製)上記の二酸

10

化チタン分散液49.60gに、ジペンタエリスリトルヘキサクリレート(DPHA、日本化薬(株)製)を18.08g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)を0.920g、光増感剤(カヤキュア-DETX、日本化薬(株)製)を0.307g、メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを500g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して中屈折率層用の塗布液を調製した。

20

【0081】(高屈折率層用塗布液の調製)上記の二酸化チタン分散液110.0gに、ジペンタエリスリトルヘキサクリレート(DPHA、日本化薬(株)製)を6.29g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)を0.520g、光増感剤(カヤキュア-DETX、日本化薬(株)製)を0.173g、メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを460.0g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して高屈折率層用の塗布液を調製した。

20

【0082】(低屈折率層用塗布液の調製)市販のシリカ微粒子のメタノール分散液(メタノールシリカゾル、濃度30重量%、日産化学(株)製)500gに、シランカップリング剤(KBM-503、信越化学工業(株)製)7.5gおよび0.1N塩酸5.0gを加え、室温で5時間攪拌した後、5日間室温で放置して、シランカップリング剤処理したシリカ微粒子のメタノール分散液を調製した。シランカップリング剤処理したシリカ微粒子のメタノール分散液121.0gに、ジペンタエリスリトルヘキサクリレート(DPHA、日本化薬(株)製)を7.43g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)を0.297g、光増感剤(カヤキュア-DETX、日本化薬(株)製)を0.149g、メチルイソブチルケトンを300g、2-ブタノールを300g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して低屈折率層用の塗布液を調製した。

30

【0083】(オーバーコート層用塗布液の調製)熱架橋性含フッ素ポリマー(TN-O20C、固形分濃度6重量%、メチルイソブチルケトン溶液、JSR(株)製)50.0gに、メチルイソブチルケトンを110.6g、シクロヘキサンを39.4g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してオーバーコート層用の塗布液を調製した。

40

【0084】(反射防止膜の作製)80μmの厚さのトリアセチルセルロースフィルム(TAC-TD80U、富士写真フィルム(株)製)上に、上記のハードコート層用塗布液を、バーコーターを用いて塗布した。90℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ6μmのハードコート層を形成した。ハードコート層の上に、上記の中屈折率層用塗布液をバーコーターを用

50

いて塗布した。60°Cで乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、中屈折率層（屈折率1.70、膜厚70nm、TT0-55B、21体積%）を形成した。中屈折率層の上に、上記の高屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60°Cで乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、高屈折率層（屈折率1.95、膜厚50nm、TT0-55B、51体積%）を形成した。高屈折率層の上に、上記の低屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60°Cで乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、低屈折率層（屈折率1.40、膜厚75nm）を形成した。低屈折率層の上に、上記のオーバーコート層用塗布液をバーコーターを用いて固形分塗布量が35mg/m²になるように塗布した。120°Cで10分加熱して、オーバーコート層を形成した。このようにして反射防止膜を作製した。

【0085】（反射防止膜の評価）作製した反射防止膜について、下記項目の評価を行った。結果を表1、表2に示す。

（1）白化試験

サンシャインウェザーメーター（S-80、スガ試験機（株）製）を用いて、サンシャインカーボンアーク灯、相対湿度60%、90時間の条件で白化試験を行った。露光前後における反射防止膜の白化の程度を観察して、以下の3段階で評価した。

- A：目視で白化が全く認められなかった
- B：目視で白化が少し認められた
- C：目視で白化が顕著に認められた

【0086】（2）ヘイズの評価

ヘイズメーター（NHD-1001DP、日本電色工業（株））で、前記露光前後のヘイズを評価した。

（3）平均反射率の評価

分光光度計（日本分光（株）製）を用いて、380～780nmの波長領域において、入射角5°における分光反射率を測定した。前記露光前後の450～650nmにおける平均反射率を求めた。

【0087】（4）動摩擦係数の評価

反射防止膜の低屈折率層を有する側の表面の滑り性の指標として動摩擦係数を評価した。動摩擦係数は試料を温度25°C、相対湿度60%の条件で2時間調湿した後、動摩擦係数測定機（HEIDON-14）で、直径5mmのステンレス剛球を用い、荷重100g、速度60cm/分で測定した。

（5）鉛筆硬度の評価

前記露光前後の反射防止膜を温度25°C、相対湿度60%の条件で2時間調湿した後、JIS S6006が規定する試験用鉛筆を用いて、JIS K5400に規定される鉛筆硬度の評価方法に従い、1kg加重における鉛筆硬度を評価した。

（6）スチルウール擦り耐性の評価

前記露光前後の反射防止膜において、#0000のスチ

ルワールに500g/cm²の荷重をかけ、50往復したときの傷の状態を観察して、以下の3段階で評価した。

- A：傷が全く付かない
- B：少し傷が付くが見えにくい
- C：顕著に傷が付く

【0088】（7）接触角の評価

反射防止膜を温度25°C、相対湿度60%の条件で2時間調湿した。反射防止膜の低屈折率層を有する側の表面の水に対する接触角を評価した。

（8）指紋拭き取り性の評価

前記露光前後の反射防止膜の表面に指紋を付着させて、それをクリーニングクロスで拭き取った時の状態を観察して、以下の3段階で評価した。

- A：指紋が完全に拭き取れた
- B：指紋の一部が拭き取れずに残った
- C：指紋のほとんどが拭き取れずに残った

（9）マジック（登録商標）拭き取り性の評価

前記露光前後の反射防止膜の表面に油性マジック（ZEBRAマッキー、赤）を付着させて30分経過させ、それをクリーニンググロスで拭き取った時の状態を観察して、以下の3段階で評価した。

- A：マジックが完全に拭き取れた
- B：マジックの一部が拭き取れずに残った
- C：マジックのほとんどが拭き取れずに残った

【0089】（10）低屈折率層の空隙率の評価

低屈折率層に含有される素材から求まる屈折率と低屈折率層の分光反射率曲線から求まる屈折率の比較から空隙率を算出した。

（11）オーバーコート層材料の低屈折率層の空隙占有率の評価

オーバーコート層塗布前後の分光反射率曲線の形状から塗布前後の屈折率変動を見積もり、オーバーコート層材料の低屈折率層の空隙占有率を求めた。

【0090】【比較例1】

（二酸化チタン微粒子分散液の調製）コア／シェル構造でない二酸化チタン微粒子（TT0-55N、シェル材料；なし、石原産業（株）製）30.0重量部、市販のアニオニ性モノマー（PM-21、日本化薬（株）製）4.5重量部、市販のカチオン性モノマー（DMAEA、（株）興人）0.3重量部およびシクロヘキサンノン65.2重量部を、サンドグラインダーミルにより分散し、重量平均径55nmの二酸化チタン分散液を調製した。

【0091】（中屈折率層用塗布液の調製）上記の二酸化チタン分散液45.14gに、ジペンタエリスリトリールヘキサアクリレート（DPHA、日本化薬（株）製）を18.74g、光重合開始剤（イルガキュア907、チバガイギー社製）を0.941g、光増感剤（カヤキユア-DETX、日本化薬（株）製）を0.314g、

メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを500g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して中屈折率層用の塗布液を調製した。

【0092】(高屈折率層用塗布液の調製) 上記の二酸化チタン分散液100.2gに、ジペンタエリスリトルヘキサアクリレート(DPHA、日本化薬(株)製)を7.76g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)を0.566g、光増感剤(カヤキュー-DET-X、日本化薬(株)製)を0.189g、メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを460.0g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して高屈折率層用の塗布液を調製した。

【0093】(反射防止膜の作製) 実施例1で作製したハードコート層の上に、上記の中屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、中屈折率層(屈折率1.70、膜厚70nm、TT0-55N、19体積%)を形成した。中屈折率層の上に、上記の高屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、高屈折率層(屈折率1.95、膜厚50nm、TT0-55N、47体積%)を形成した。高屈折率層の上に、実施例1で調製した低屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、低屈折率層(屈折率1.40、膜厚75nm)を形成した。低屈折率層の上に、実施例1で調製したオーバーコート層用塗布液をバーコーターを用いて固形分塗布量が35mg/m²になるように塗布した。120℃で10分加熱して、オーバーコート層を形成した。このようにして反射防止膜を作製した。

(反射防止膜の評価) 作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0094】[実施例2]

(二酸化チタン微粒子分散液の調製) 二酸化チタン微粒子(TT0-55D、シェル材料；アルミナ/酸化ジルコニウム(粒子全体の22重量%、石原産業(株)製)30.0重量部、市販のアニオン性モノマー(PM-21、日本化薬(株)製)4.5重量部、市販のカチオン性モノマー(DMAEA、(株)興人)0.3重量部およびシクロヘキサン65.2重量部を、サンドグラインダーミルにより分散し、重量平均径54nmの二酸化チタン分散液を調製した。

【0095】(中屈折率層用塗布液の調製) 上記の二酸化チタン分散液57.85gに、ジペンタエリスリトルヘキサアクリレート(DPHA、日本化薬(株)製)を16.86g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)を0.910g、光増感剤(カヤキュー-DET-X、日本化薬(株)製)を0.189g、メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを460.0g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して中屈折率層用の塗布液を調製した。

【0096】(高屈折率層用塗布液の調製) 上記の二酸化チタン分散液128.5gに、ジペンタエリスリトルヘキサアクリレート(DPHA、日本化薬(株)製)を3.57g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)を0.519g、光増感剤(カヤキュー-DET-X、日本化薬(株)製)を0.173g、メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを460.0g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して高屈折率層用の塗布液を調製した。

【0097】(反射防止膜の作製) 実施例1で作製したハードコート層の上に、上記の中屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、中屈折率層(屈折率1.70、膜厚70nm、TT0-55D、25体積%)を形成した。中屈折率層の上に、上記の高屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、高屈折率層(屈折率1.95、膜厚50nm、TT0-55D、59体積%)を形成した。

【0098】高屈折率層の上に、実施例1で調製した低屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、低屈折率層(屈折率1.40、厚さ75nm)を形成した。低屈折率層の上に、実施例1で調製したオーバーコート層用塗布液をバーコーターを用いて固形分塗布量が35mg/m²になるように塗布した。120℃で10分加熱して、オーバーコート層を形成した。このようにして反射防止膜を作製した。

(反射防止膜の評価) 作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0099】[実施例3] コア/シェル構造の二酸化チタン微粒子(TT0-55A、シェル材料；アルミナ(粒子全体の5重量%)、石原産業(株)製)30.0重量部、市販のアニオン性モノマー(PM-21、日本化薬(株)製)4.5重量部、市販のカチオン性モノマー(DMAEA、(株)興人)0.3重量部およびシクロヘキサン65.2重量部を、サンドグラインダーミルにより分散し、重量平均径54nmの二酸化チタン分散液を調製した。

【0100】(中屈折率層用塗布液の調製) 上記の二酸化チタン分散液47.52gに、ジペンタエリスリトルヘキサアクリレート(DPHA、日本化薬(株)製)を18.39g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)を0.910g、光増感剤(カヤキュー-DET-X、日本化薬(株)製)を0.189g、メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを460.0g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して中屈折率層用の塗布液を調製した。

チバガイギー社製)を0.931g、光増感剤(カヤキューーDETX、日本化薬(株)製)を0.311g、メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを500g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して中屈折率層用の塗布液を調製した。

【0101】(高屈折率層用塗布液の調製)上記の二酸化チタン分散液105.5gに、ジペンタエリスリトルヘキサアクリレート(DPHA、日本化薬(株)製)を6.97g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)を0.542g、光増感剤(カヤキューーDETX、日本化薬(株)製)を0.181g、メチルエチルケトンを230.0gおよびシクロヘキサンを460.0g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して高屈折率層用の塗布液を調製した。

【0102】(反射防止膜の作製)実施例1で作製したハードコート層の上に、上記の中屈折率用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、中屈折率層(屈折率1.70、膜厚70nm、TT0-55A、20体積%)を形成した。中屈折率層の上に、上記の高屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、高屈折率層(屈折率1.95、膜厚50nm、TT0-55A、49体積%)を形成した。高屈折率層の上に、実施例1で調製した低屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。60℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、低屈折率層(屈折率1.40、膜厚75nm)を形成した。低屈折率層の上に、実施例1で調製したオーバーコート層用塗布液をバーコーターを用いて固形分塗布量が35mg/m²になるように塗布した。120℃で10分加熱して、オーバーコート層を形成した。このようにして反射防止膜を作製した。

(反射防止膜の評価)作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0103】[実施例4]

(オーバーコート層用塗布液の調製)熱架橋性含フッ素ポリマー(JN-7214、固形分濃度6重量%、メチルイソブチルケトン溶液、JSR(株)製)50.0gに、メチルイソブチルケトンを110.6g、シクロヘキサンを39.4g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してオーバーコート層用の塗布液を調製した。

【0104】(反射防止膜の作製)実施例1で作製した低屈折率層の上に、上記のオーバーコート層用塗布液をバーコーターを用いて固形分塗布量が35mg/m²になるように塗布した。120℃で10分加熱して、オーバーコート層を形成した。このようにして反射防止膜を

作製した。

【0105】(反射防止膜の評価)作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0106】[実施例5]

(オーバーコート層用塗布液の調製)重量平均分子量が20万である市販の含フッ素ポリマー(サイトップCTX-809A、旭硝子(株)製)3.0gに、市販のフッ素系溶剤(フロリナートFC77、住友3M(株)製)を197.0g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してオーバーコート層用の塗布液を調製した。

【0107】(反射防止膜の作製)実施例1で作製した低屈折率層の上に、上記のオーバーコート層用塗布液をバーコーターを用いて固形分塗布量が35mg/m²になるように塗布した。120℃で10分加熱して、オーバーコート層を形成した。このようにして反射防止膜を作製した。

(反射防止膜の評価)作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0108】[実施例6]

(オーバーコート層用塗布液の調製)紫外線架橋性含フッ素ポリマー(TN-011、固形分濃度6重量%、メチルイソブチルケトン溶液、JSR(株)製)50.0gに、メチルイソブチルケトンを110.6g、シクロヘキサンを39.4g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してオーバーコート層用の塗布液を調製した。

【0109】(反射防止膜の作製)実施例1で作製した低屈折率層の上に、上記のオーバーコート層用塗布液をバーコーターを用いて固形分塗布量が35mg/m²になるように塗布した。120℃で10分加熱して、オーバーコート層を形成した。このようにして反射防止膜を作製した。

(反射防止膜の評価)作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0110】[実施例7]

(オーバーコート層用塗布液の調製)含フッ素シランカップリング剤(KP-801M、信越化学(株)製)1.0gに、市販のフッ素系溶剤(フロリナートFC77、住友3M(株)製)を330g添加して攪拌した。孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してオーバーコート層用の塗布液を調製した。

【0111】(反射防止膜の作製)実施例1で作製した低屈折率層の上に、上記のオーバーコート層用塗布液をバーコーターを用いて固形分塗布量が5mg/m²になるように塗布した。120℃で30分加熱して、オーバーコート層を形成した。このようにして反射防止膜を

製した。

(反射防止膜の評価) 作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0112】 [実施例8]

(低屈折率層用塗布液の調製) 热架橋性含フッ素ポリマー (TN-020C、固体分濃度6重量%、メチルイソブチルケトン溶液、JSR(株)製) を用いた。孔径0.4mのポリプロピレン製フィルターで濾過して低屈折率層用の塗布液を調製した。

【0113】 (反射防止膜の作製) 実施例1で作製した高屈折率層の上に、上記の低屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。120℃で10分加熱して、低屈折率層(屈折率1.42、膜厚97nm)を形成した。このようにして反射防止膜を作製した。

(反射防止膜の評価) 作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0114】 [比較例2]

(反射防止膜の作製) 比較例1で作製した高屈折率層の上に、実施例8で調製した低屈折率層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。120℃で10分加熱して、低屈折率層(屈折率1.42、膜厚97nm)を形成した。このようにして反射防止膜を作製した。

(反射防止膜の評価) 作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0115】 [実施例9]

(反射防止膜の作製) 実施例1の中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層の形成において、酸素濃度が2~4%の雰囲気になるように窒素パージしながら、紫外線を照射して塗布層を硬化させた。それ以外は実施例1と全く同様にして反射防止膜を作製した。(反射防止膜の評価) 作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0116】 [実施例10]

(反射防止膜の作製) 実施例8の中屈折率層、高屈折率層の形成において、酸素濃度が2~4%の雰囲気になるように窒素パージしながら、紫外線を照射して塗布層を*

[ドープの組成(重量部)]

トリアセチルセルロース	
(酢化度: 59.5%)	
ソルビトールヘキサアセテート	2
酢酸メチル	4.8
シクロヘキサン	2.0
メタノール	5
エタノール	5
シリカ(粒径20nm)	0.1
2,4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3,5-ジ-tert-ブチルアニリノ)-1,3,5-トリアジン	0.1

* 硬化させた。それ以外は実施例8と全く同様にして反射防止膜を作製した。

(反射防止膜の評価) 作製した反射防止膜について、実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0117】 [実施例11]

(反射防止膜の作製) 膜厚80mのトリアセチルセルロースフィルム(TAC-TD80UF、富士写真フィルム(株)製)の片面のみを酸化処理した。酸化されていない側の面に実施例1で調製したハードコート層用塗布液をバーコーターを用いて塗布した。90℃で乾燥した後、紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ6μmのハードコート層を形成した。ハードコート層の上に、実施例10と同様に中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層、オーバーコート層を形成した。このようにして、反射防止膜を作製した。

(偏光板の作製) 膜厚75μmのポリビニルアルコールフィルム((株)クラレ製)を水1000重量部、ヨウ素7重量部、ヨウ化カリウム105重量部からなる水溶液に5分間浸漬し、ヨウ素を吸着させた。次いで、このフィルムを40℃の4重量%ホウ酸水溶液で、4.4倍に縦方向に1軸延伸をした後、緊張状態のまま乾燥して偏光膜を作製した。接着剤としてポリビニルアルコール系接着剤を用いて、上記偏光膜の一方の面に反射防止膜のトリアセチルセルロースフィルムの酸化処理された側の面を貼り合わせた。さらに、偏光膜のもう片方の面に、酸化処理したトリアセチルセルロースフィルムを同じポリビニルアルコール系接着剤を用いて貼り合わせた。このようにして、偏光板を作製した。

(偏光板の評価) 作製した偏光板について実施例1と同様に評価を行った。結果を表1、表2に示す。

【0118】 [実施例12]

(12-1) トリアセチルセルロース溶液の作製下表に示す組成の化合物を添加後、室温(25℃)にて3時間放置した。得られて不均一なゲル状溶液を、-70℃にて6時間冷却した後、50℃に加温し攪拌してトリアセチルセルロース溶液を作製し、内層および表面層用のドープをそれぞれ調製した。溶解方法は以下の通りである。

[内層]	[表面層]
2.0	1.9
2	2
4.8	4.9
2.0	2.0
5	5
5	5
0.1	0.1
2,4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3,5-ジ-tert-ブチルアニリノ)-1,3,5-トリアジン	

粘度 (45°C)

【0119】 (12-2) トリアセチルセルロースフィルムの作製
これらのドープを三層共流延ダイを用い、内層用ドープが内側に表面層用ドープが両外側になるように配置して金属支持体上に同時に吐出させて重層流延した後、流延膜を支持体から剥ぎ取り、乾燥して、本発明の三層構造のトリアセチルセルロースフィルム積層体（内層の厚さ：7.4 μm、各表面層の厚さ：3 μm）を製造した。10 乾燥は70°Cで3分、130°Cで5分した後、ガラス板からフィルムを剥ぎ取り、そして160°C、30分で段*

0.2
160 Pa · S 110 Pa · S

* 階的に乾燥して溶剤を蒸発させフィルムを得た。

(12-3) 反射防止膜の作製、偏光板の作製、偏光板の評価

(12-2) で作製したトリアセチルセルロースフィルムを用いる以外は、実施例11と全く同様にして反射防止膜の作製、偏光板の作製、偏光板の評価を行った。結果を表1、2に示す。

【0120】

【表1】

	白化試験	ヘイズ(%)		平均反射率(%)		動摩擦係数	鉛筆硬度		スチールウール擦り耐性	
		前	後	前	後		前	後	前	後
実施例1	A	0.2	0.2	0.52	0.53	0.09	3H	3H	A	A
比較例1	C	0.4	2.5	0.54	0.83	0.09	3H	H	A	C
実施例2	A	0.3	0.3	0.53	0.52	0.09	3H	3H	A	A
実施例3	B	0.2	0.3	0.53	0.57	0.09	3H	2H	A	A
実施例4	A	0.1	0.1	0.65	0.64	0.10	3H	3H	A	A
実施例5	A	0.2	0.2	0.53	0.52	0.20	3H	3H	A	A
実施例6	A	0.2	0.2	0.55	0.54	0.10	3H	3H	A	A
実施例7	A	0.2	0.2	0.36	0.37	0.30	3H	3H	B	B
実施例8	A	0.1	0.1	0.35	0.36	0.09	2H	2H	B	B
比較例2	C	0.4	2.3	0.37	0.68	0.09	2H	H	B	C
実施例9	A	0.2	0.2	0.52	0.53	0.09	3H	3H	A	A
実施例10	A	0.1	0.1	0.35	0.36	0.09	2H	2H	B	B
実施例11	A	0.2	0.2	0.52	0.53	0.09	3H	3H	A	A
実施例12	A	0.2	0.2	0.51	0.52	0.09	3H	3H	A	A

【0121】

※30※【表2】

	接触角(°C)	指紋拭き取り性		マジック拭き取り性		低屈折率層の空隙率(体積%)	オーバーコート層材料の空隙占有率(体積%)
		前	後	前	後		
実施例1	103	A	A	A	A	16.3	51.2
比較例1	103	A	A	A	A	16.2	51.3
実施例2	103	A	A	A	A	16.3	51.1
実施例3	103	A	A	A	A	16.5	50.9
実施例4	101	A	A	A	A	16.4	100
実施例5	105	A	A	A	A	16.3	49.6
実施例6	100	A	A	A	A	16.2	52.5
実施例7	98	B	B	A	A	16.1	14.0
実施例8	103	A	A	A	A	0	—
比較例2	103	A	A	A	A	0	—
実施例9	103	A	A	A	A	16.3	51.2
実施例10	103	A	A	A	A	0	—
実施例11	103	A	A	A	A	16.3	51.2
実施例12	103	A	A	A	A	16.2	51.3

【0122】

【発明の効果】本発明の反射防止膜は、塗布により簡単に製造することができ、大量生産に適している。また、

屈折率が非常に高く、透明な高屈折率層を有する反射防止膜を提供できる。さらにまた、物理的強度（耐摩耗性など）と耐候性（耐光性、耐湿熱性）に優れた高屈折率

層を有する反射防止膜を提供できる。以上のような反射防止膜を用いることで、画像表示装置の画像表示面における光の反射を有效地に防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】反射防止膜の様々な層構成を示す断面模式図である。

【図2】本発明の高屈折率層に用いる好ましい態様におけるコア/シェル構造を有する無機微粒子の断面模式図である。

【図3】本発明の好ましい態様における高屈折率層の断面模式図である。

【図4】本発明の好ましい態様における低屈折率層の断面模式図である。

【図5】本発明の好ましい態様における低屈折率層とオーバーコート層の断面模式図である。

【図6】反射防止膜を画像表示装置に適用する様々な態様を示す断面模式図である。

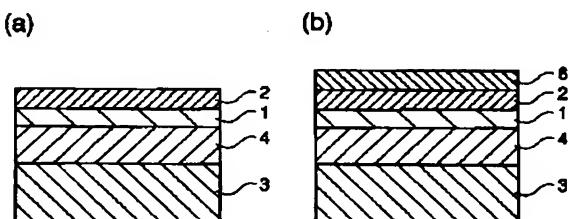
【符号の説明】

1 高屈折率層

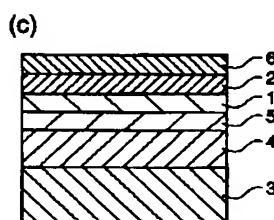
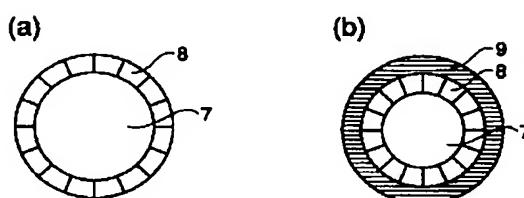
- * 2 低屈折率層
- 3 透明支持体
- 4 ハードコート層
- 5 中屈折率層
- 6 オーバーコート層
- 7 コア
- 8 シェル
- 9 シェル
- 11 高屈折率層内の無機微粒子
- 12 高屈折率層内のポリマー
- 21 低屈折率層内の無機微粒子
- 22 低屈折率層内のポリマー
- 23 低屈折率層内の空隙
- 61 オーバーコート層内の含フッ素微粒子
- イ 粘着剤層
- ロ-1 偏光板保護膜
- ロ-2 偏光板保護膜
- ハ 偏光板

*

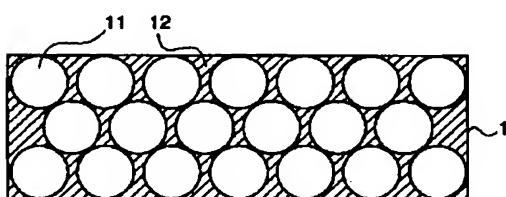
【図1】



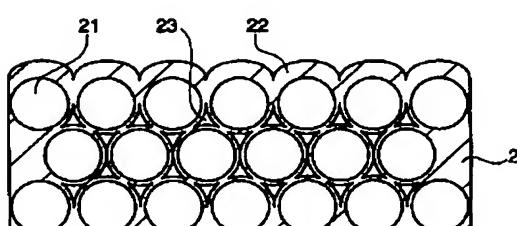
【図2】



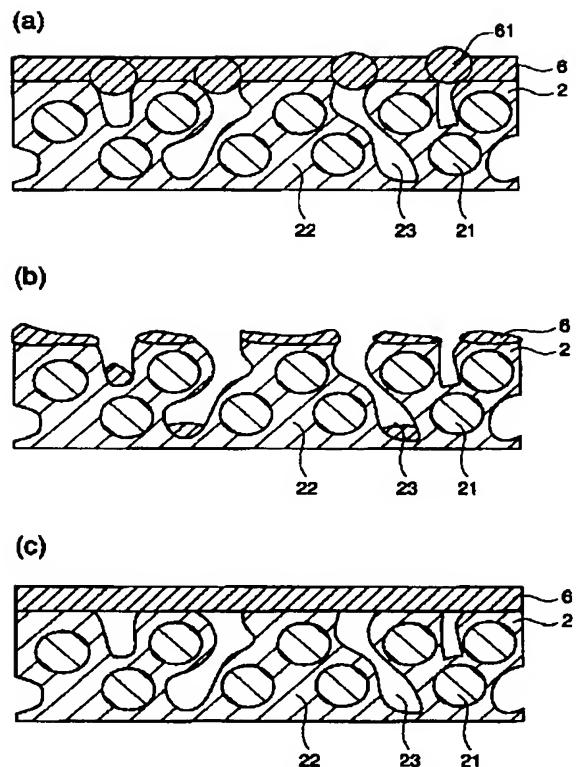
【図3】



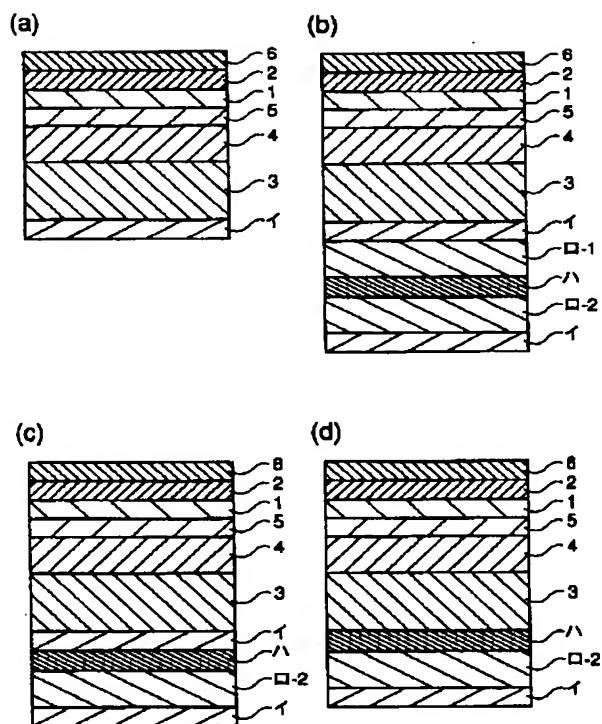
【図4】



【図5】



【図6】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷
 G 02 B 5/30
 G 02 F 1/1335 識別記号 500

F I
 G 02 F 1/1335
 G 02 B 1/10 テーマコード (参考)
 500
 A